

ສັນຖາເລກທີ R2562B067



## รายงานວิจัยฉบับสมบูรณ์

ລັກສະນະເພາະຂອງເຊຣາມືກ KNNS-BNKZ ທີ່ສັງເຄຣະດ້ວຍວິທີກາຣເພາໄໝ້  
Characterization of KNNS-BNKZ ceramics synthesized via  
Combustion method



ຮອງຄາສຕຣາຈາຣຍ ດຣ.ເງົ່າຮ້າຍ ບົກກາຣນ  
ການວິທະຍາພິສິກສ ຄະວິທະຍາສຕຣ ມາວິທະຍາລໍາຍນເຮົວ

ສຳເນົາກົດລະບົບ	ລາຍລະອຽດລະບົບ
ລັດທະບາບ	ກາງ
ລັດທະບາບ	(039)787
ລັດທະບາບ	TP
ລັດທະບາບ	823
ລັດທະບາບ	0669
ລັດທະບາບ	2562

ສນັບສຸນໂດຍບປະມານແຜ່ນດິນມາວິທະຍາລໍາຍນເຮົວ

ປີງປປະມານ 2562

## กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยนเรศวร  
ปีงบประมาณ 2562 ผู้วิจัยและคณะขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชาพิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกท่านที่อำนวย  
ความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ

ขอขอบคุณ Science Lab Center คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สนับสนุนเครื่องมือ  
และอุปกรณ์ในการทำวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย บงการณ์ และคณะ



หัวข้อวิจัย	ลักษณะเฉพาะของเซรามิก KNNS-BNKZ ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการเผาใหม่
นักวิจัย	รองศาสตราจารย์ ดร. ชีระชัย บงกชารณ์

### บทคัดย่อ

เซรามิกชนิดโพลิโซอิเล็กทริก  $0.96(\text{K}_{0.46}\text{Na}_{0.545})\text{Nb}_{0.95}\text{Sb}_{0.05}\text{O}_3 - 0.04\text{Bi}_{0.5}(\text{Na}_{0.82}\text{K}_{0.18})_{0.5}\text{ZrO}_3$  (KNNS-BNKZ) ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาใหม่ โดยใช้ไกลซีนเป็นเชื้อเพลิง และศึกษาผลของอุณหภูมิการเผา (ใช้อุณหภูมิแคลไชน์ 650-850 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และใช้อุณหภูมิชินเตอร์ 1050-1150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง) ที่มีต่อโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก KNNS-BNKZ ผงผลึกแสดงโครงสร้างแบบเพอร์ฟไกด์ในทุกตัวอย่าง โดยพบว่า ผงผลึกมีความบริสุทธิ์ เมื่อแคลไชน์ที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โครงสร้างจุลภาคมีลักษณะเป็นเหลี่ยม ขนาดของอนุภาคเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 0.414 เป็น 0.534 ไมโครเมตร เมื่ออุณหภูมิแคลไชน์เพิ่มขึ้นจาก 650 เป็น 850 องศาเซลเซียส เซรามิกแสดงโครงสร้างแบบสมรรถห่วงเทหะโกรนัลและออร์โรรอมบิกในทุกตัวอย่าง เซรามิกมีขนาดเกรนเฉลี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 1.07 ถึง 2.05 ไมโครเมตร เมื่ออุณหภูมิชินเตอร์เพิ่มขึ้นจาก 1050 ถึง 1150 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิชินเตอร์ 1125 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เซรามิก KNNS-BNKZ แสดงค่าความหนาแน่นสูงสุดที่  $4.60 \text{ g/cm}^3$  และค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่  $T_C(E_C)$  เท่ากับ 5000



**Research Topic:** Characterization of KNNS-BNKZ ceramics synthesized via Combustion method  
**Researcher:** Assoc. Prof. Dr. Theerachai Bongkarn

### Abstract

The piezoelectric ceramics of  $0.96(K_{0.46}Na_{0.545})Nb_{0.95}Sb_{0.05}O_3 - 0.04Bi_{0.5}(Na_{0.82}K_{0.18})_{0.5}ZrO_3$  (KNNS-BNKZ) were prepared via combustion method using glycine as fuel. Effect of firing temperatures (calcination temperature of 650-850°C for 2 h and sintering temperature of 1050-1150°C for 2 h) on crystal structure, microstructure and electric properties of KNNS-BNKZ ceramics were studied. The perovskite phase was observed in all samples. KNNS-BNKZ powder at the calcined temperature of 850°C for 2 h showed the pure perovskite phase. The particles morphology exhibited square shape. The average particle size increased from 0.414 to 0.534  $\mu m$  by increase of calcination temperature from 650°C to 850°C. The KNNS-BNKZ ceramics exhibited a single perovskite structure with coexistence of the tetragonal and orthorhombic phases. The average grain size increased from 1.07  $\mu m$  to 2.05  $\mu m$  by increase of sintering temperature from 1050°C to 1150°C. At a sintered temperature of 1125°C for 2 h, KNNS-BNKZ ceramic showed the highest density of 4.60 g/cm<sup>3</sup> and dielectric properties at  $T_c$  ( $\epsilon_c$ ) of 5000.

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย

เซรามิกพิโซอิเล็กทริก เช่น PZT, PMN เป็นเป็นเซรามิกที่นำมาประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากแสดงสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม แต่อย่างไรก็ตามการระเหยของ PbO ในระหว่างกระบวนการสังเคราะห์เซรามิกที่มีต่ำกว่าเป็นองค์ประกอบหลักก่อให้เกิดผลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์ อีกทั้งการระเหยของ PbO ยังทำให้เกิดความไม่แนนอนต่อองค์ประกอบทางเคมีของเซรามิก เมื่อไม่นานมานี้งานวิจัยจำนวนมากศึกษาเกี่ยวกับเซรามิกพิโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วที่มีสมบัติทางไฟฟ้าที่ดี เพื่อนำมาใช้ทดแทนเซรามิกที่มีต่ำกว่าเป็นองค์ประกอบหลักเซรามิก ( $K_{0.5}Na_{0.5}$ )NbO<sub>3</sub> (KNN) เป็นวัสดุพิโซอิเล็กทริกชนิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากเซรามิกดังกล่าวมีสมบัติพิโซอิเล็กทริกที่ดี ( $d_{33} \sim 160\text{pC/N}$ ) สมบัติเพร์โตรอิเล็กทริกที่ยอดเยี่ยม ( $P_r = 33\mu\text{C/cm}^2$ ) อีกทั้งมีอุณหภูมิครุยสูง ( $T_c = 420^\circ\text{C}$ ) แต่การสังเคราะห์เซรามิก KNN ให้มีความหนาแน่นสูงทำได้ยากด้วยน้ำแข็งมี Ting Zheng ,Jiagang Wu ,Dingquan Xiao และ Jianguo Zhu ปรับปรุงความหนาแน่นและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก KNN โดยการเจือ Sb แทนที่ Nb ในตำแหน่ง B ของโครงสร้างรวมทั้งเติม  $\text{Bi}_{0.5}(\text{Na}_{0.82}\text{K}_{0.18})_{0.5}\text{ZrO}_3$  ให้เป็นเซรามิกในระบบสององค์ประกอบโดยพบร่วมกับเซรามิก  $0.96(\text{K}_{0.46}\text{Na}_{0.545})\text{Nb}_{0.95}\text{Sb}_{0.05}\text{O}_3 - 0.04\text{Bi}_{0.5}(\text{Na}_{0.82}\text{K}_{0.18})_{0.5}\text{ZrO}_3$  (KNNS-BNKZ) แสดงค่า  $d_{33} \sim 496\text{ pC/N}$  และ  $k_p \sim 47\%$  [1-3]

โดยทั่วไปแล้วการเตรียมเซรามิก KNNS-BNKZ สังเคราะห์โดยใช้วิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการดั้งเดิมโดยใช้อุณหภูมิในการเผาต่อรูสูงและใช้ระยะเวลาในการสังเคราะห์นาน ผงผลึกที่สังเคราะห์ได้ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน และอนุภาคมีขนาดใหญ่ ต่อมาวิธีการเผาใหม่เป็นวิธีการใหม่ที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน โดยสังเคราะห์ผงผลึกจากปฏิกิริยาการคายความร้อนจากเชื้อเพลิงในการเกิดปฏิกิริยาการเผาใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างสารเคมีและเชื้อเพลิง (เช่น ญเรีย, ไกลชีน, กรดซิตริก, อะลานิน หรือ คาร์บอไไฮดรไซด์) ระหว่างกระบวนการการเผาใหม่ ซึ่งเป็นวิธีการที่ประสบผลสำเร็จในการเตรียมเซรามิกที่มีคุณภาพสูง วิธีการนี้ข้อดีหลักประการเช่น ผงผลึกที่ได้มีความเป็นเนื้อเดียวกัน ขั้นตอนการเตรียมง่าย และอุณหภูมิการเตรียมต่ำและประหยัดเวลา แต่อย่างไรก็ตามการเตรียมผงผลึกและเซรามิก KNNS-BNKZ โดยวิธีการเผาใหม่เป็นวิธีที่ยังไม่ได้รับการศึกษาดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเตรียมผงผลึกและเซรามิก KNNS-BNKZ โดยวิธีการเผาใหม่และศึกษาผลของอุณหภูมิแคลลิไซน์และชินเตอร์ที่มีผลต่อโครงสร้างไฟฟ้า โครงสร้างจุลภาค สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกนี้

#### 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- เพื่อศึกษาการเตรียมผงผลึก KNNS-BNKZ ด้วยวิธีการเผาใหม่โดยใช้ไกลชีน (Glycine) เป็นเชื้อเพลิง โดยใช้อุณหภูมิแคลลิไซน์ระหว่าง 650 ถึง 850 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
- เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิชินเตอร์ระหว่าง 1050 ถึง 1150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ที่มีต่อโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก KNNS-BNKZ

### 1.3 ขอบเขตการวิจัย

1. เตรียมเซรามิก KNNS-BNKZ ด้วยวิธีการเผาใหม่
2. ศึกษาโครงสร้างผลึกด้วยเครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ (XRD) ศึกษาโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ศึกษาสมบัติทางกายภาพ เช่น ความหนาแน่น การหดตัว รูปทรง ศึกษาสมบัติโดยอิเล็กทริกด้วยเครื่อง LCR สมบัติไฟฟ้าโดยอิเล็กทริกด้วยเครื่อง quasistatic d<sub>33</sub> testing meter และศึกษาสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริกด้วยเครื่อง computer-controlled modified sawyer-tower circuit
3. วิเคราะห์ผลที่ได้และสรุป

### 1.4 ระเบียบวิธีวิจัย

1. ค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเตรียมการทดลอง
2. เตรียมผงผลึก KNNS-BNKZ ด้วยเทคนิคการเผาใหม่โดยมีเงื่อนไขของอุณหภูมิแคลใจนท์ที่ต่างกัน
3. เตรียมเซรามิก KNNS-BNKZ ด้วยเทคนิคการเผาใหม่โดยมีเงื่อนไขของอุณหภูมิชินเตอร์ที่ต่างกัน
4. ศึกษาโครงสร้างผลึกด้วยเครื่องเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (XRD) ศึกษาโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ศึกษาสมบัติทางกายภาพ เช่น ความหนาแน่น การหดตัว รูปทรง รวมถึงศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกที่เตรียมได้
5. วิเคราะห์ผลที่ได้ สรุปผลการทดลอง
6. ทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และเตรียมการนำเสนอ

### 1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ทำให้ทราบอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเตรียมผงผลึก KNNS-BNKZ ด้วยวิธีการเผาใหม่โดยใช้ไกลซีน (Glycine) เป็นเชื้อเพลิง
2. ทำให้ทราบผลของอุณหภูมิชินเตอร์ที่มีผลต่อโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก KNNS-BNKZ

### 1.6 สมมติฐานของงานวิจัย

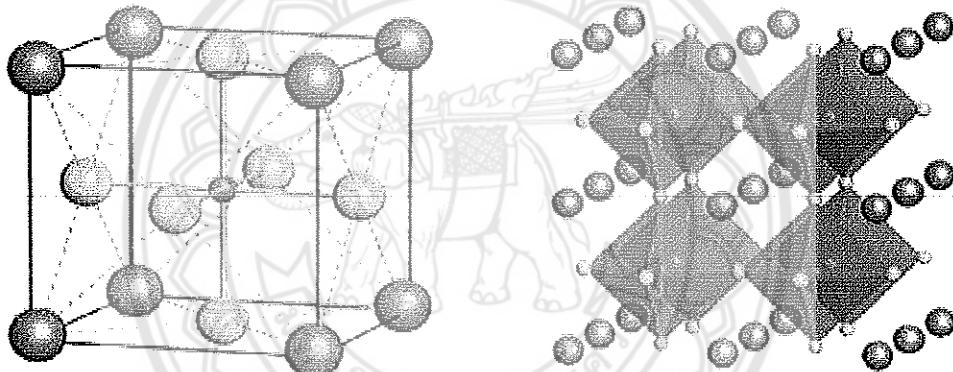
1. สามารถเตรียมผงผลึก KNNS-BNKZ ด้วยวิธีการเผาใหม่โดยใช้ไกลซีนเป็นเชื้อเพลิงได้
2. อุณหภูมิชินเตอร์มีผลต่อโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก KNNS-BNKZ

## บทที่ 2

### ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 โครงสร้างเพอร์อฟไกต์ (perovskite structure)

โครงสร้างเพอร์อฟไกต์มีสูตรทางเคมีคือ  $\text{ABO}_3$  ประกอบด้วยอะตอมของไอออนบวกที่มีรัศมีอะตอมขนาดใหญ่กว่าตัวอยู่ที่ตำแหน่ง A (A-site) ซึ่งอยู่ที่มุนทุกมุมของหน่วยเซลล์ (unit cell) และมีค่าความเป็นประจุไฟฟ้าต่ำกว่าอาทิเช่น  $\text{K}^+$ ,  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Sr}^{2+}$ ,  $\text{Ba}^{2+}$  และ  $\text{Pb}^{2+}$  ส่วนที่ตำแหน่ง B (B-site) ซึ่งอยู่ตรงกลางของหน่วยเซลล์จะมีอะตอมของไอออนบวกที่มีรัศมีอะตอมขนาดเล็กและมีค่าความเป็นประจุไฟฟ้าสูงกว่าตัวอยู่อาทิเช่น  $\text{Ta}^{5+}$ ,  $\text{Ti}^{4+}$ ,  $\text{Zr}^{4+}$  และ  $\text{Sn}^{4+}$  โดยไอออนบวกนี้จะถูกกล้อมรอบด้วยไอออนลบของออกซิเจน 6 ตัวซึ่งตัวกันเป็นรูปอكتะดิรอต (octahedral) ดังแสดงในภาพ 1



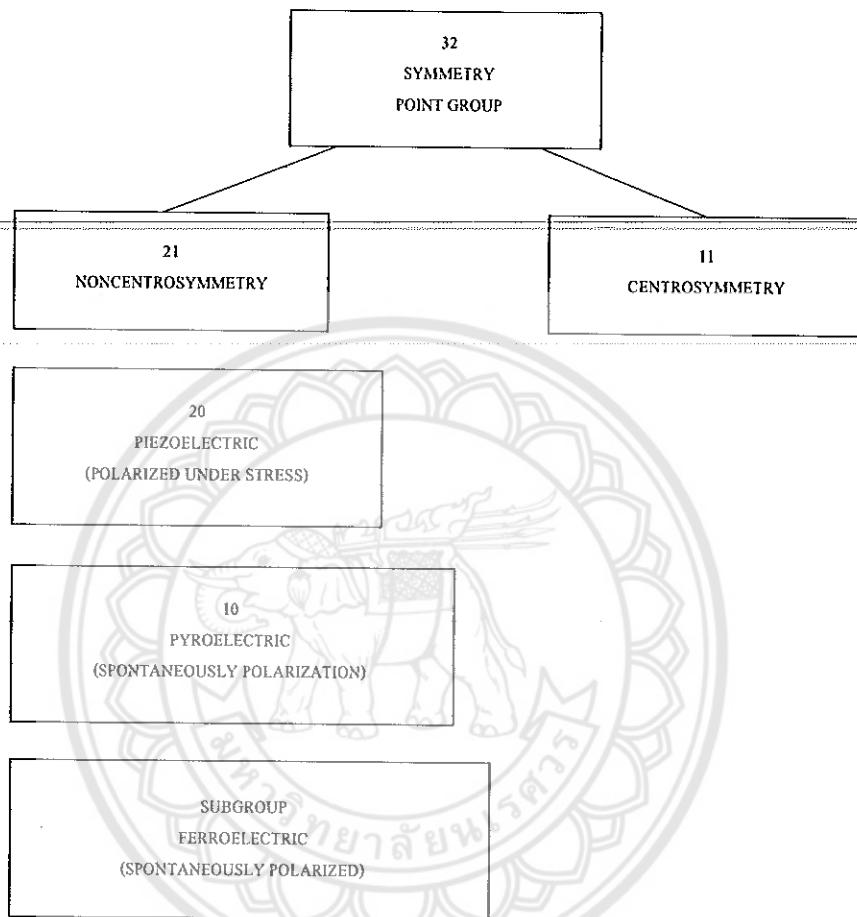
ภาพ 1 โครงสร้างแบบเพอร์อฟไกต์ ( $\text{ABO}_3$ )

#### 2.2 ไฟอิโซอิเล็กทริก (Piezoelectric) [4]

คำว่า “ไฟอิโซ (piezo)” มาจากภาษากรีกซึ่งแปลว่า “กด” ดังนั้นสมบัติไฟอิโซอิเล็กทริกคือการเกิดกระแสไฟฟ้าที่เป็นผลมาจากการได้รับแรงกด ปรากฏการณ์ไฟอิโซอิเล็กทริก (piezoelectric) ได้ถูกค้นพบครั้งแรกโดยชองส์และปีแอร์คุรี (Jacques and Pierre Curie) ในปี ค.ศ.1880 ขณะที่ศึกษาผลของการดันต่อประจุไฟฟ้าของผลึกบางประเภท เช่น ควอร์ซ (quartz) ซิงค์เบลนด์ (zincblende) หัวมาลีน (tourmaline) การเกิดกระแสไฟฟ้าที่เป็นผลมาจากการได้รับแรงกดซึ่งเป็นแรงทางกลทำให้เกิดความเครียด (strain) ในผลึกมีผลทำให้เกิดการจัดเรียงตัวของไดโพลโมเมนต์ (dipole moment) ไปในทิศทางเดียวกันเรียกว่าการโพลาไรเซชัน (polarization) และให้กระแสไฟฟ้าออกมายโดยปริมาณและเครื่องหมายของการโพลาไรเซชันจะแปรผันตามความเครียดที่ได้รับและในทางกลับกันเมื่อให้สนามไฟฟ้าแก่สารจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือความเครียดขึ้นในสนามไฟฟ้าที่ให้เข้าไป

ความเข้าใจในโครงสร้างภายในของวัสดุนั้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาสมบัติไฟอิโซอิเล็กทริกของแข็งเมื่อทำการพิจารณาวัสดุที่มีผลึกเดี่ยวพบว่าผลึกมีองค์ประกอบทางเคมีคงที่และ

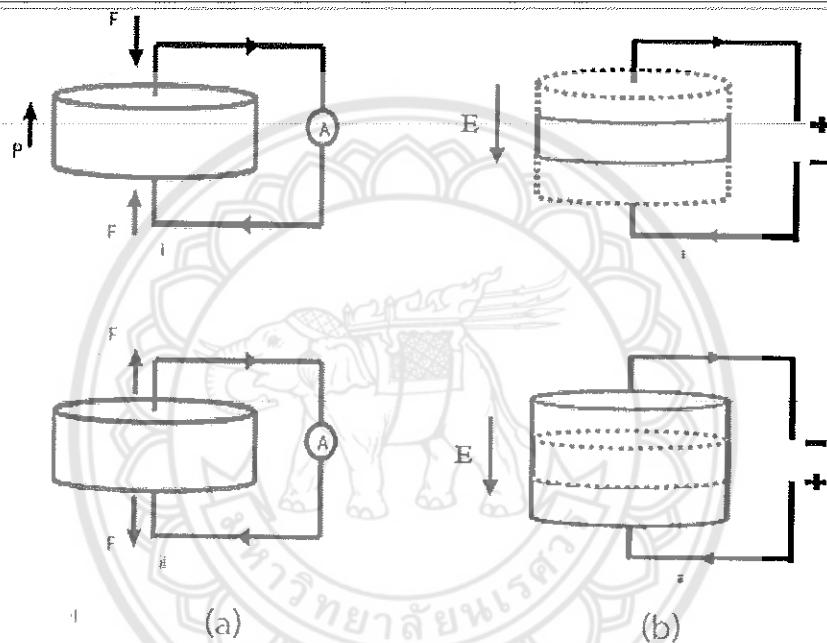
ประกอบด้วยไอออน (อะตอมที่มีประจุ) เรียงตัวกันซ้ำๆ ต่อ กันเป็นเครือข่ายเกิดเป็นระนาบผลึก (lattice) หน่วยที่เล็กที่สุดที่มีความสมมาตรเรียกว่าหน่วยเซลล์ และเป็นตัวบอกความเป็นไปได้ของการมีสมบัติไฟอิโซเล็กทริกในผลึกเนื่องจากความสามารถของโครงสร้างผลึกภายในถูกสะท้อนด้วยความสมมาตรของสมบัติที่วัสดุนั้นแสดงออก



ภาพ 2 การแบ่งกลุ่มของผลึกของวัสดุใน 32 กลุ่ม

นักผลึกศาสตร์แบ่งผลึกออกเป็น 32 กลุ่ม ดังแสดงในภาพ 2 จากผลึก 32 กลุ่ม ดังกล่าว มี 21 กลุ่มที่ไม่มีสมมาตรของศูนย์กลาง (noncentrosymmetric) ซึ่งเป็นลักษณะที่สำคัญที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ไฟอิโซเล็กทริกซึ่งพบถึง 20 กลุ่ม การไม่มีสมมาตรของศูนย์กลางเป็นสภาวะสำคัญที่ทำให้เกิดสภาพไฟอิโซเล็กทริกแต่แรงดึงที่ให้กับวัสดุเป็นแบบที่มีสมมาตรของศูนย์กลางและไม่สามารถทำให้เกิดการโพลาไรเซชัน เช่น การเกิดโพลาไรเซชันแบบเวกเตอร์ (vector-quality-like Polarization) นอกจากวัสดุนั้นจะมีลักษณะไม่มีสมมาตรของศูนย์กลางอยู่ซึ่งจะทำให้ผลรวมของการเคลื่อนที่ของประจุบวกและลบสามารถสร้างได้โพลาไฟฟ้าขึ้นมาหรือที่เรียกว่าเกิดโพลาไรเซชันนั้นเอง ความแตกต่างของวัสดุที่เป็นไฟอิโซเล็กทริก กับเฟอร์โรอิโซเล็กทริกคือวัสดุไฟอิโซเล็กทริกไม่สามารถเกิดโพลาไรเซชันด้วยตัวมันเองแต่จะเกิดเมื่อให้แรงทางกลต่อผลึกเท่านั้น

สภาพไฟอิโซอิเล็กทริกเกิดขึ้นได้สองแบบคือแบบที่เป็นเส้นตรง (direct effect) และแบบผันกลับได้ (converse effect) ซึ่งแบบแรกเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโพลาไรเซชันเมื่อสารถูกแรงกลกระทำ (หรือเกิดความเด่น) เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นปรากฏการณ์ไฟอิโซอิเล็กทริกแบบเส้นตรง เช่นเครื่องกำเนินสัญญาณ (generator) ส่วนอีกแบบหนึ่งเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงขนาดและปริมาตร (หรือเกิดความเครียด) ในสนามไฟฟ้าที่ให้เข้าไปเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ไฟอิโซอิเล็กทริกแบบผันกลับได้ เช่น มอเตอร์ (motor) ซึ่งกลไกทั้งสองแบบแสดงในภาพ 3 และระดับการเกิดโพลาไรเซชันจะขึ้นกับระดับความเครียดที่เกิดจากแรงที่ได้รับและเครื่องหมายของประจุที่เกิดขึ้นอยู่กับว่าแรงที่ให้เป็นแรงดึงหรือแรงกด



ภาพ 3 แสดงปรากฏการณ์ไฟอิโซอิเล็กทริก (a) แบบเส้นตรง และ (b) แบบผันกลับได้ สมบัติดังกล่าวอาจพบได้ในเซรามิกไฟอิโซอิเล็กทริกซึ่งก็คือเฟโรอิเล็กทริกที่ผ่านการสร้างข้าว (poling) นั่นเองในระหว่างกระบวนการสร้างข้าววัสดุจะเกิดการขยายตัวตามแนวแกนการสร้างข้าวเล็กน้อยและเกิดการหดตัวในทิศทางที่ตั้งฉากกับทั้งสองทิศทางเล็กน้อยเช่นกันระดับความแรงของสนามที่สร้างข้าวและอุณหภูมิเป็นปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดการจัดทิศทางและสมบัติที่ได้ของวัสดุการจัดเรียงตัวไม่มีทางเสร็จสมบูรณ์และโครงสร้างผลึกของวัสดุก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกระดับการสร้างข้าวได้ด้วยเช่นเฟสเทรอโนนัลทำได้ถึงร้อยละ 83 เพื่อรอมโบไฮดรัลทำได้ถึงร้อยละ 86 และสำหรับเฟสօอร์ไทรอมบิกมากถึงร้อยละ 91 ซึ่งเป็นค่าที่สูงเมื่อเทียบกับค่าที่ได้จากผลึกเดียวหรือโดยเมนเดียวกันล่าว่าได้ว่าเซรามิกทุกชนิดที่ผ่านการเผาผนึก (sintering) แล้วจะมีสมบัติเหมือนกันในทุกทิศทุกทาง (isotropic) เมื่อมองโดยรวม จะเห็นว่าการผ่านการสร้างข้าวเพื่อทำให้มีสมบัติไฟอิโซอิเล็กทริก โดยที่วัสดุเหล่านั้นเป็นทั้งสารเฟโรอิเล็กทริกและเป็นไฟอิโซอิเล็กทริกด้วย กระบวนการสร้างข้าวเป็นกระบวนการการหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้เกิดสภาพไฟอิโซอิเล็กทริกในเซรามิกชนิดเฟรโร อิเล็กทริกหากไม่มีการสร้างข้าวเซรามิกจะไม่เปลี่ยนสภาพแม้ว่าแต่ละผลึกจะเป็นไฟอิโซอิเล็กทริกอยู่แล้วก็ตามเซรามิกที่ผ่านการสร้างข้าวเซรามิกจะไม่เปลี่ยนสภาพแม้ว่าแต่ละผลึกจะเป็น

ไฟอิโซอิเล็กทริกอยู่แล้วก็ตาม เชรามิกที่ผ่านการสร้างขึ้นมีประ予以ชน์มากมายเมื่อใช้งานที่อุณหภูมิไม่เกิน อุณหภูมิคิรี (curie temperature:  $T_c$ ) เพราะเชรามิกจะเสียสภาพโพลาไรเซชันที่เกิดจากการสร้างขึ้นที่ อุณหภูมิสูงกว่า  $T_c$

จาก 20 point groups ของผลึกไม่มีสมมาตรที่เป็นไฟอิโซอิเล็กทริกจะมีอยู่ 10 point groups ที่ มีข้อ (polar) เกิดได้โดยไม่แน่ตัวว่าตอนแม่ไม่ได้รับสนามไฟฟ้ากระทำ สารกลุ่มนี้เป็นสารที่เกิดโพลา ไรเซชันขึ้นเองได้ (Spontaneous Polarization) ผลึกมีข้อเหล่านี้เป็นไฟอิโซอิเล็กทริกอย่างมากและใน กรณีที่ให้สนามไฟฟ้าแรงพอที่เข้าไปจะทำให้ศักดิ์สิทธิ์ของเวกเตอร์โพลาไรเซชันเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งในสาร point groups นี้เรียกว่าเฟอร์โรอิเล็กทริกนั้นคือสารเฟอร์โรอิเล็กทริกทุกชนิดเป็นสารไฟอิโซอิเล็กทริก แต่ ไฟอิโซอิเล็กทริกไม่จำเป็นต้องเป็นเฟอร์โรอิเล็กทริก ผลึกเฟอร์โรอิเล็กทริกจะแสดงสมบัติของโมเมนต์คู่ควบ (dipole-moment) ถึงแม้ว่าเราได้นำสนามไฟฟ้าออกแล้วก็ตามกล่าวว่ามีไฟเดลโน้มเนนต์การอยู่ในผลึก ในสถานะเฟอร์โรอิเล็กทริกจุดศูนย์กลางของประจุบวกของผลึกไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกับประจุลบเมื่อเรา เอาสารไดอิเล็กทริกมาวางในสนามไฟฟ้าจะเกิดโพลาไรเซชันขึ้นภายใต้แรงนั้นและเมื่อลดสนามไฟฟ้าที่ให้ จนเป็นศูนย์โพลาไรเซชันในสารไดอิเล็กทริกก็จะกลับเป็นศูนย์ทันทีแต่มีสารบางอย่างเมื่อเราให้ สนามไฟฟ้าภายนอกเข้าไปทำให้เกิดมีโพลาไรเซชันและเมื่อลดสนามไฟฟ้าลงจนเป็นศูนย์โพลาไรเซชัน จะไม่เป็นศูนย์ในสารไดอิเล็กแต่มักจะเป็นศูนย์เมื่อ  $E = -E_c$  และว่าในสารมีโมเมนต์ข้อคู่ต่อการอยู่แล้วหรือ อาจกล่าวได้ว่าสารนั้นแสดงสถานะเป็นเฟอร์โรอิเล็กทริกและอาจทำให้สารแสดงสถานะเฟอร์โรอิเล็กทริกโดย ไม่ต้องใช้สนามไฟฟ้าเลยแต่เราใช้การลดอุณหภูมิแทนโดยปกติสถานะเฟอร์โรอิเล็กทริกจะไม่ปรากฏที่ อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิที่แน่นอนค่าหนึ่งที่เรียกว่าอุณหภูมิวิกฤต ( $T_c$ ) ที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิวิกฤตนั้น ผลึกจะอยู่ในสถานะพาราอิเล็กทริก (paraelectric)

### 2.3 เฟอร์โรอิเล็กทริก (Ferroelectric) [5]

สารเฟอร์โรอิเล็กทริกเป็นสารที่ไม่มีความสมมาตรกับจุดศูนย์กลางของหน่วยเซลล์จึงทำให้สามารถ สร้างไฟโพลาร์ขึ้นมาได้โดยไม่ต้องได้รับแรงกลั่นสามารถแยกสารเฟอร์โรอิเล็กทริกออกจากวัสดุไดอิเล็กทริก ด้วยการตกค้างหรือรีมาเนนท์โพลาไรเซชัน (remanent polarization:  $P_r$ ) เมื่อสนามไฟฟ้าที่ใส่เข้าไปมีค่า เป็นศูนย์ โดยปกตินั้นโพลาไรเซชัน ( $P$ ) เป็นผลมาจากการนำไฟฟ้าซึ่งจัดเรียงข้อคู่อะตอม (atomic dipole) หรือข้อมูล (molecular dipole) อย่างเป็นระเบียบในสารหลายชนิดโพลาไรเซชันเป็นสัดส่วนโดยตรง กับสนามไฟฟ้าเมื่อสนามไฟฟ้า  $E$  มีความเข้มน้อย

$$P = \epsilon_0 \chi_e E \quad (1)$$

เมื่อ  $\chi_e$  เป็นค่าคงที่เรียกว่าสภาพรับได้ทางไฟฟ้า (electric susceptibility) ของตัวกลางค่าของ  $\chi_e$  สภาพรับได้ทางไฟฟ้า ขึ้นกับโครงสร้างทางจุลภาค (microscopic structure) ของสารที่พิจารณาและ  $\epsilon_0$  เป็นส่วนของสัญญาการ permittivity of a vacuum) มีค่าคงที่ประมาณ  $8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$  โปรดสังเกตว่า สนามไฟฟ้าในสมการ (1) นี้เป็นสนามไฟฟ้าทั้งหมดซึ่งอาจเกิดจากส่วนของประจุอิสระและ ส่วนของโพลาไรเซชันที่สนาม  $E$  ผลิตขึ้นเอง  $\chi_e$  ไม่มีศักดิ์สิทธิ์และการขัดไฟฟ้า (electric displacement:  $D$ ) มาจากการกระจายประจุอิสระเท่านั้นซึ่งมีความสัมพันธ์ตามสมการ (2)

$$D = \epsilon_0 E + P \quad (2)$$

จากสมการ (1) และ (2) จะได้ความสัมพันธ์เป็น

$$D = \epsilon_0 E + \epsilon_0 \chi_e E = \epsilon_0 (1 + \chi_e) E \quad (3)$$

ดังนั้นไม่เพียงแต่  $P$  เท่ากับที่ขึ้นกับ  $E$  แต่  $D$  ก็ขึ้นกับ  $E$  ด้วยเช่นกัน

$$D = \epsilon E \quad (4)$$

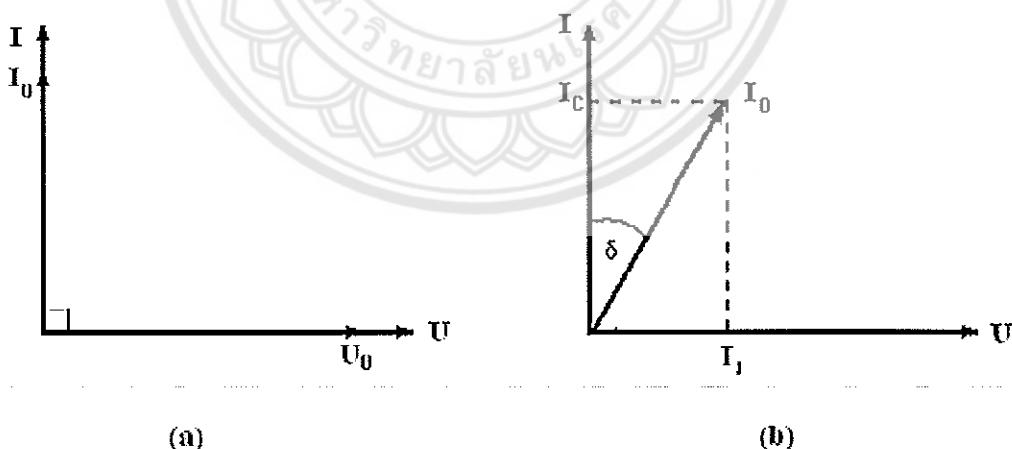
$$\epsilon = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \quad (5)$$

เรียก  $\epsilon$  ว่าสภายอม (Permittivity) ของวัสดุในสัญญาณ ไม่มีสารใดก่อให้เกิดโพลาเรช์ ดังนั้นสภายอมที่ได้จากการไฟฟ้าจะเป็นศูนย์และสภายอม ( $\epsilon$ ) จะมีค่าเท่ากับ  $\epsilon_0$  และจากสมการ (5) จะได้

$$\epsilon_r = (1 + \chi_e) = \epsilon / \epsilon_0 \quad (6)$$

เมื่อ  $\epsilon_r$  คือสภายอมสัมพันธ์ (relative permittivity) หรือค่าคงที่โดยอิเล็กทริก

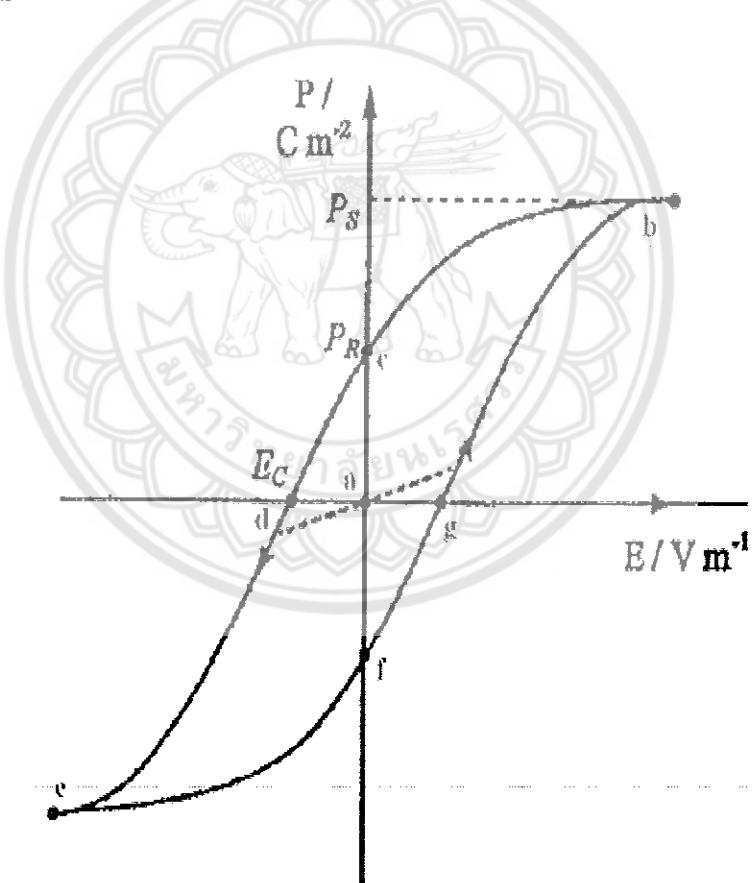
ในวัสดุเฟริโอเล็กทริกส่วนใหญ่ค่าคงที่โดยอิเล็กทริก  $\epsilon_r$  จะมีค่าสูงดังนี้  $P > \epsilon_0 E$  และ  $D \approx P$  เมื่อป้อนไฟฟ้ากระแสสลับให้กับวัสดุโดยอิเล็กทริกสามารถไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าภายในวัสดุโดยอิเล็กทริกในกรณีอุดมคติไฟฟ้าภายในวัสดุโดยอิเล็กทริกสามารถกระแสลับทิศทางได้ตามความถี่ของแหล่งกำเนิดกระแสกระแสสลับ ( $I$ ) และศักย์ไฟฟ้า ( $V$ ) มีความต่างไฟฟ้าอยู่ 90 องศาดังภาพ 4 (ก) ทำให้ผลคูณสเกลาร์ (scalar product) ของ  $I$  และ  $V$  เท่ากับศูนย์ดังนั้นจึงไม่มีการสูญเสียพลังงานของวัสดุโดยอิเล็กทริก (dielectric loss:  $\tan \delta$ ) เกิดขึ้น แต่ในความเป็นจริงการลับทิศทางของไฟฟ้าจะก่อให้เกิดความต้านทานภายในเนื้อวัสดุเองทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานขึ้นซึ่งกรณีนี้กระแสไฟฟ้ากับศักย์ไฟฟ้ามีความต่างไฟฟ้าน้อยกว่า 90 องศาดังภาพ 4 (ข) โดยการสูญเสียพลังงานที่เกิดขึ้นนี้สามารถวัดได้จากการทดลองและเป็นอัตราส่วนโดยตรงกับสภายอม



ภาพ 4 ความต่างไฟฟ้าระหว่างกระแสสลับ ( $I$ ) และศักย์ไฟฟ้า ( $V$ ) ของวัสดุโดยอิเล็กทริก  
(ก) กรณีไม่มีการสูญเสียพลังงาน (ข) กรณีมีการสูญเสียพลังงาน

ในวัสดุเฟริโอเล็กทริกการลับทิศทางของไฟฟ้าตามความถี่ของแหล่งกำเนิดได้ความสัมพันธ์ระหว่างการโพลาเรชันและสนามไฟฟ้า (Polarization versus field) ซึ่งความสัมพันธ์จะพบในรูปของวงรอบไฮสเทอเรชีส (hysteresis loop) ดังภาพ 5

เมื่อให้สนามไฟฟ้าเข้าไปครั้งแรกการเกิดโพลาไรเซชันเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งถึงจุดอิ่มตัว (saturation polarization) คือจุด b ซึ่งการเกิดโพลาไรเซชันมีค่ามากที่สุดโดยโพลทั้งหมดจะเรียงตัวขนานกันและหากเพิ่มสนามไฟฟ้าไปมากกว่านั้นก็ไม่มีผลต่อการเกิดโพลาไรเซชันเมื่อสนามไฟฟ้ามีค่าลดลงแทนที่การโพลาไรเซชันจะถอยกลับไปตามเส้นทางเดินเหมือนตอนเริ่มต้น ( $P = 0$ ) แต่กลับไปสู่ทิศทางที่แตกต่างกันแม้ว่าไม่มีการให้สนามไฟฟ้า ( $E = 0$ ) แก้วัสดุเฟรโรอิเล็กทริกก์ตามแต่ยังคงมีโพลาไรซ์ลงเหลืออยู่หรือรีเมเนนท์โพลาไรเซชัน (remanent value:  $P_r$ ) ที่จุด c ถ้าเราต้องการกำจัดโพลาไรเซชันที่ยังคงเหลืออยู่เราต้องให้สนามไฟฟ้าย้อนกลับทิศทางเดิม (นั่นคือ  $-E$ ) โพลาไรเซชันจะลดลงสู่ศูนย์ที่จุด d ซึ่งเรียกจุดนี้ว่าสนามโคเครอร์ซีฟ (coercive field:  $E_c$ ) ถ้าเราพยายามให้สนามไฟฟ้าในทิศทางลบนี้สูงขึ้นอีกในที่สุดก็จะถึงจุดอิ่มตัวที่จุด e ขึ้นได้โดยทั้งหมดที่ไปทางขวาเมื่อลิงขึ้นตอนนี้ถ้าไม่ป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับวัสดุเฟรโรอิเล็กทริกแล้วปล่อยให้วัสดุที่มีโพลาไรเซชันเพิ่มขึ้นไปทางขวาจุด f เพื่อให้ครบวงจรต้องป้อนกระแสไฟฟ้าอีกครั้งในทิศทางบวกโพลาไรเซชันจะกลับสู่ศูนย์ที่จุด g และในที่สุดก็จะมุ่งไปสู่จุดอิ่มตัวที่จุด b



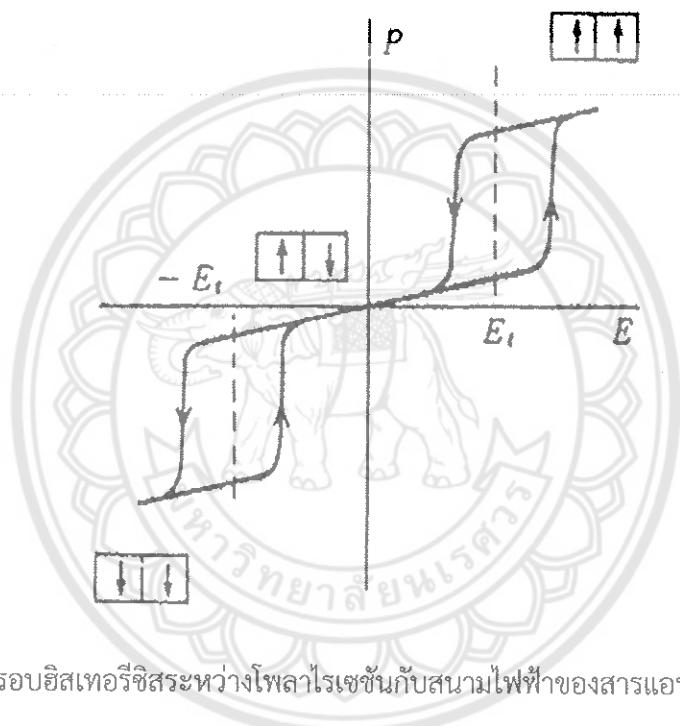
ภาพ 5 วงรอบอิสเทอริเชิร์ชระหว่างโพลาไรเซชันกับสนามไฟฟ้าในสารเฟรโรอิเล็กทริก

#### 2.4 แอนติเฟรโรอิเล็กทริก (Anti ferroelectric) [6]

สารแอนติเฟรโรอิเล็กทริกเป็นสารที่สามารถเกิดโพลาไรเซชันได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรับแรงกลเข่นเดียวกับสารเฟรโรอิเล็กทริก แต่ทิศทางของโพลาไรเซชันในแต่ละโดเมน (โดเมน คือ บริเวณที่หน่วย

1039987

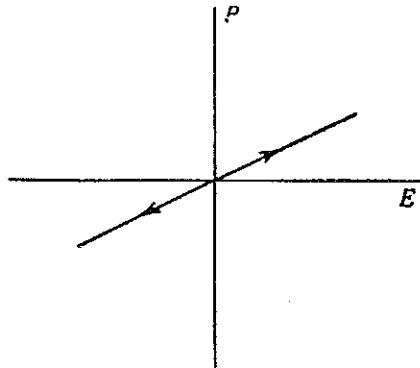
เซลล์มีสภาพขั้วเหมือนกัน) จะมีทิศทางตรงกันข้ามกันเกิดการหักล้างกัน ทำให้ค่าโพลาไรเซชันสุทธิ (net polarizations) มีค่าเป็นศูนย์สารแอนติเฟร์โรบาร์ชนิดเมื่อถูกเหนี่ยวนำโดยสนามไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนเป็นสารเฟริโรอิเล็กทริกได้ในสนามไฟฟ้าต่ำ สารแอนติเฟริโรอิเล็กทริกจะมีค่าโพลาไรเซชันที่ถูกเหนี่ยวนำ (induced polarizations) เป็นสัดส่วนโดยตรงกับสนามไฟฟ้า เมื่อสนามไฟฟ้าที่ใส่เข้าไปมีค่าเกินกว่าสนามไฟฟ้าวิกฤต (critical field,  $E_{crit}$ ) ทำให้ผลึกภายในเป็นเฟริโรอิเล็กทริกและโพลาไรเซชันจะแสดงอีสเทอเริชีสที่มีความสัมพันธ์กับสนามไฟฟ้า หากหยุดป้อนสนามไฟฟ้าดังกล่าวผลึกจะกลับเป็นสถานะแอนติโพลาร์ (anti polar state) และโพลาไรเซชันที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองนั้น จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในขณะนั้น โดยธรรมชาติของสารแอนติเฟริโรอิเล็กทริกจะมีวงรอบอีสเทอเริชีส 2 วง (double hysteresis curve) ดังภาพ 6



ภาพ 6 วงรอบอีสเทอเริชีสระหว่างโพลาไรเซชันกับสนามไฟฟ้าของสารแอนติเฟริโรอิเล็กทริก

## 2.5 พาราอิเล็กทริก (Paraelectric) [6]

เฟสพาราอิเล็กทริกเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิเฟสเฟริโรอิเล็กทริกและเฟสแอนติเฟริโรอิเล็กทริก ซึ่งสารพาราอิเล็กทริกจะประพฤติตัวเป็นวนวนตามปกติ มีโครงสร้างที่สมมาตร จึงไม่สามารถเกิดโพลาไรเซชันได้ด้วยตนเอง เมื่อมีการป้อนสนามไฟฟ้าให้กับสารพาราอิเล็กทริก ทำให้เกิดโพลาไรเซชันขึ้น แต่เมื่อยุดป้อนสนามไฟฟ้าเข้าไป ผลึกคงไม่มีการเกิดโพลาไรเซชันขึ้นอีก ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เดียวกับภาพ 7



ภาพ 7 วงรอบไฮสเทอเรซิสระหว่างโพลาไรเซชันกับสนามไฟฟ้าในสารพาราอิเล็กทริก

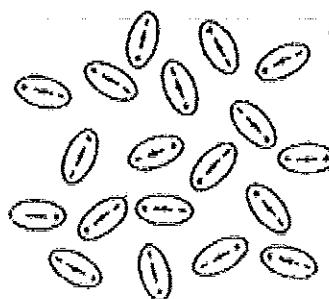
## 2.6 สมบัติไดอิเล็กทริก (Dielectric properties) [7]

สมบัติไดอิเล็กทริก คือ สมบัติของการเป็นอนุนวยไฟฟ้าในวัสดุ เมื่อยูในสภาพปกติจะประกอบไปด้วยโมเลกุลที่มีจุดศูนย์กลางมวลร่วมกันระหว่างโปรตอน และกลุ่มอิเล็กตรอน ที่อยู่ภายใต้แรงยึดของโมเลกุล และแรงยึดของอะตอม ภายในเนื้อสารจะไม่มีประจุไฟฟ้าอิสระ แต่เมื่อมีสนามไฟฟ้าผ่านเข้าไปในสารดังกล่าวจะทำให้โมเลกุลเกิดแรงทางไฟฟ้า เนื่องจากสนามไฟฟ้ากระทำกับโมเลกุลจะทำให้กลุ่มประจุบวกถูกผลักไปในทิศทางของสนาม และกลุ่มประจุลบจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม ทำให้โมเลกุลของสารเกิดเป็นโมเมนต์ขั่วคู่ (dipole moment) ขึ้นมา ดังแสดงในภาพ 8



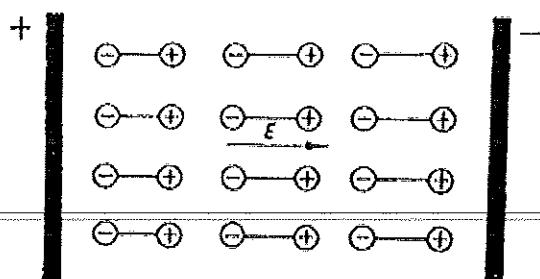
ภาพ 8 แสดงการเกิดโพลาไรซ์ของอะตอม

นอกจากนี้ยังมีกรณีของสารไดอิเล็กทริกที่โมเลกุลมีความเป็นขั่วคู่อยู่ก่อนแล้ว เพียงแต่ทิศทางของขั่วคู่มีความไม่เป็นระเบียบดังแสดงในภาพ 9



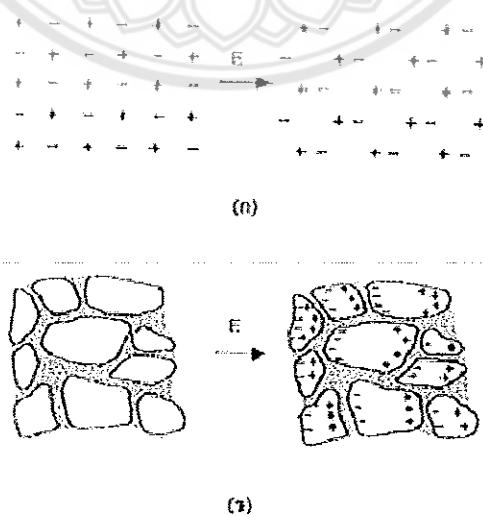
ภาพ 9 ลักษณะของขั่วคู่ที่วางทิศทางอย่างไม่เป็นระเบียบ

เมื่อมีสนามไฟฟ้าภายนอกมากระทำ จะทำให้ชั่วครู่เล็กๆ เหล่านี้เกิดการเรียงตัวในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระเบียบ เมื่อพิจารณามวลสารทั้งหมดของสารได้อิเล็กทริก จะเห็นว่าประจุบวกทั้งหมดเคลื่อนทั่งออกจากประจุลบ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า สารได้อิเล็กทริกนั้นลูกโพลาไรซ์ (polarized) ดังแสดงในภาพ 10



ภาพ 10 การเกิดโพลาไรซ์ของสารได้อิเล็กทริก

นอกจากกระบวนการ atomic polarizations และ dipole polarizations ที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ยังมีกระบวนการ ionic polarizations และ space charge polarizations ที่สามารถทำให้เกิดโมเมนต์ชั่วครู่ได้เช่นกัน โดยกระบวนการ ionic polarization จะเกิดขึ้นกับวัสดุที่มีพันธะไอออนิกที่เกิดการเลื่อนตำแหน่งของไอออนบวกและไอออนลบไปจากสมดุลของแลตทิซพารามิเตอร์ในโครงสร้างผลึกเนื่องจากมีสนามไฟฟ้าภายนอกเข้ามานำหนายืนทำให้มีชั่วครู่ สำหรับกรณีกระบวนการ space charge polarization นั้น จะเกิดขึ้นกับวัสดุที่มีขอบgren เมื่อจากสนามไฟฟ้าภายนอกมาเหนียวนำทำให้ประจุที่อยู่ในสภาวะสมดุล เกิดการเคลื่อนที่จากตำแหน่งเดิมไปอยู่ที่บริเวณขอบgren ทำให้เกิดชั่วครู่ขึ้น แสดงดังภาพ 11



ภาพ 11 แสดงกระบวนการเกิดโพลาไรเซชันแบบ (a) ionic (b) space charge

## 2.7 การซินเตอร์ (sintering)

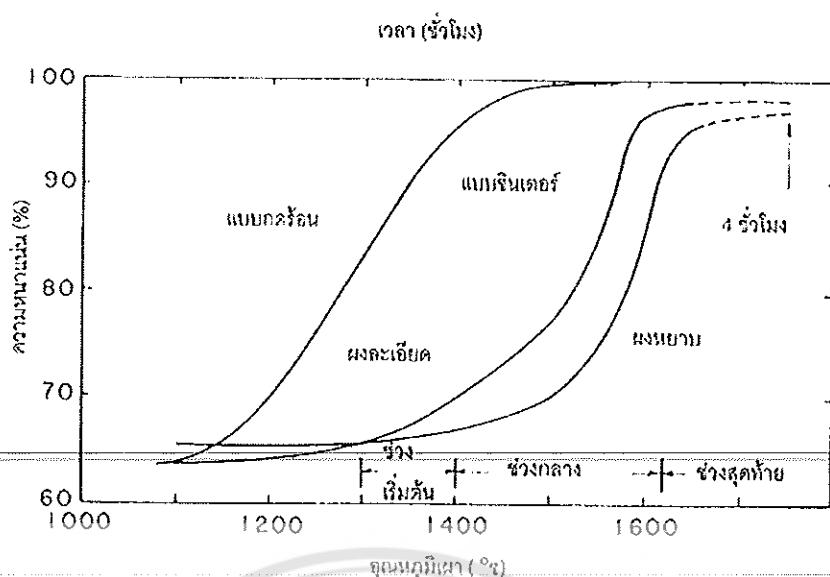
การซินเตอร์ (sintering) คือ กระบวนการทางความร้อนที่ทำใหอนุภาคเกิดการสร้างพันธะกันอย่างสมดุลโดยมีโครงสร้างหลักเป็นของแข็งที่พัฒนามาจากการเคลื่อนย้ายมวลลักษณะต่างๆ ที่มักจะเกิดขึ้นในระดับของอะตอม การเกิดพันธะเชื่อมต่อ กันถั่งกล่าวทำให้ระบบมีความแข็งแรงสูงขึ้นและมีพลังงานลดลง นอกจากนี้ยังอาจกล่าวได้ว่าการซินเตอร์นั้นหมายถึงการกำจัดรูพรุนที่อยู่ระหว่างอนุภาค ผงเริ่มต้น โดยอาศัยการหดตัวขององค์ประกอบที่เชื่อมอยู่ติดกันแล้วเกิดการเติบโตไปด้วยกัน โดยมีการสร้างพันธะที่แข็งแรงระหว่างอนุภาคที่อยู่ติดกันขึ้นมาทุกขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนสภาพชั้นงานที่ผ่านการอัดขึ้นรูป ไปเป็นโครงสร้างจุลภาคที่ประกอบด้วยการยึดเกาะกันของเกรนต่างๆ ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการซินเตอร์ทั้งสิ้น แรงขับดันสำหรับการซินเตอร์นั้นได้มาจากการลดพื้นที่ผิวและพลังงานของพื้นผิวด้วยการใช้ของแข็งที่เชื่อมติดกันโดยมีพลังงานขอบเกรนแบบของแข็ง-ของแข็ง ( $\gamma_{ss}$ ) ที่ค่อนข้างต่ำเข้าไปแทนที่ก่อนอนุภาคผงที่ยึดกันอยู่อย่างหลวมๆ ซึ่งจะมีพลังงานพื้นผิวแบบของแข็ง-ไอ ( $\gamma_{sv}$ ) ที่สูงมาก ด้วยเหตุนี้เองการผลิตเซรามิกส่วนใหญ่จึงนิยมเลือกใช้ออนุภาคผงตั้งต้นที่มีขนาดอนุภาคเล็กเนื่องจากอนุภาคผงที่มีขนาดยิ่งเล็กเท่าไรก็จะยิ่งมีพื้นที่ผิวมากขึ้นเท่านั้นจึงทำให้ระบบมีแรงขับดันสำหรับการซินเตอร์ที่สูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้ชิ้นงานสามารถเกิดการแน่นตัวได้ดี จึงมีความหนาแน่นสูง หรือทำให้สามารถใช้อุณหภูมิในการเผาที่ต่ำลงได้ [8]

การทดสอบของชิ้นงานเซรามิกชนิดที่ทำการซินเตอร์สามารถตรวจสอบได้จากการวัดขนาดหรือหาค่าความหนาแน่นของชิ้นงานขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและเวลาในการเผา ตั้ง เช่น ตัวอย่างของพฤติกรรมการซินเตอร์แบบสถานะของแข็ง (solid - state sintering) ทั่วๆ ไป ที่แสดงดังภาพ 12 ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนหลักที่มีความควบคุมต่ำตัวได้ดี จึงมีความหนาแน่นสูง หรือทำให้สามารถใช้อุณหภูมิในการเผาที่ต่ำลงได้

1. การซินเตอร์ช่วงเริ่มต้น (initial sintering) จะเกี่ยวข้องกับการจัดเรียงตัวกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง ของอนุภาคผงภายในชิ้นงานและการเกิดพันธะที่แข็งแรง หรือคอ (neck) ขึ้นมาที่บริเวณจุดสัมผัสระหว่างอนุภาคผงความหนาแน่นสัมพัทธ์ของชิ้นงานในช่วงนี้อาจจะเพิ่มขึ้นจาก 0.5 ไปถึง 0.6 ได้ส่วนใหญ่ก็เนื่องมาจากการที่อนุภาคผงมีการแพคตัวกันมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

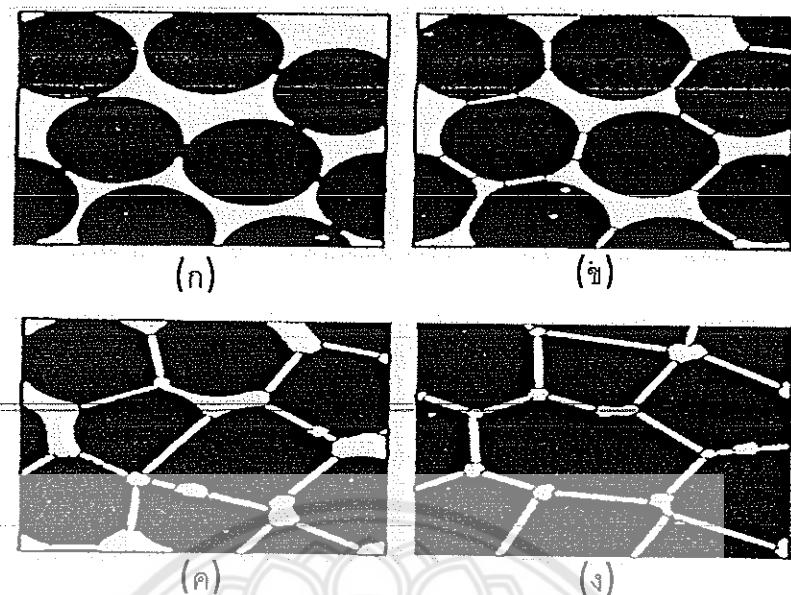
2. การซินเตอร์ช่วงกลาง (intermediate sintering) เป็นช่วงที่ขนาดของคอเริ่มโตขึ้นและปริมาณของความพรุนในชิ้นงานจะเริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอนุภาคเริ่มเข้ามาใกล้ชิดติดกันมากยิ่งขึ้น ทำให้ชิ้นงานเกิดมีการหดตัวลงอย่างชัดเจน เริ่มมีเกรนและขอบเกรนเกิดขึ้นพร้อมกับมีการเคลื่อนที่ของสิ่งเหล่านี้ ทำให้เกิดมีการเติบโตของเกรนบางเกรนขึ้น ขั้นตอนนี้จะดำเนินไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องในขณะที่ห้องว่างของรูพรุนจะเริ่มเกิดการเชื่อมต่อ กัน (พวกรูพรุนเปิด) และจะสิ้นสุดพฤติกรรมนี้ในทันทีเมื่อรูพรุนเกิดมีการแยกตัวหลุดออกไปอยู่ต่างหาก (พวกรูพรุนปิด) การหดตัวของชิ้นงานจะเกิดขึ้นมากที่สุดในการซินเตอร์ช่วงกลางนี้ และอาจจะทำให้ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของชิ้นงานมีค่าสูงถึงประมาณ

3. การซินเตอร์ช่วงสุดท้าย (final stage sintering) เป็นช่วงที่รูพรุนในชิ้นงานเริ่มปิดตัวลง และค่อยๆ ถูกกำจัดให้หมดไปจากชิ้นงานอย่างช้าๆ โดยอาศัยกลไกการแพร่ของอากาศจาก รูพรุนออกมาระหว่างของขอบเกรน แล้วหลุดออกไปจากผิวของชิ้นงาน ซึ่งจะทำให้ชิ้นงานเกิดการแน่นตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกเพียงเล็กน้อย ขนาดของเกรนจะเพิ่มขึ้นในการซินเตอร์ช่วงสุดท้ายนี้ ภาพ 13 (ง)



ภาพ 12 พฤติกรรมการซินเตอร์แบบสถานะของแข็งหัวๆ ในในรูปของความสัมพันธ์ระหว่าง  
ความหนาแน่นกับอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการเผา

การซินเตอร์แบบมีเฟสของเหลว (Liquid phase sintering) เป็นกระบวนการเผาซินเตอร์ที่มีองค์ประกอบหนึ่งของวัสดุกิดการหลอมเหลวขึ้นจนถ่ายสภาพไปเป็นของเหลวในระหว่างที่มีการซินเตอร์ ซึ่งเป็นกระบวนการอันหนึ่งที่นิยมใช้ในการผลิตเซรามิกด้วยการใช้อุณหภูมิเผาซินเตอร์ที่ต่ำลง เนื่องจากโดยปกติแล้วสัดส่วนของเซรามิกส่วนใหญ่จะมีจุดหลอมเหลวที่สูงมากบางชนิดอาจสูงถึงประมาณ 300 °C ทำให้ต้องมีการใช้พลังงานที่สูงมากในการเผาซินเตอร์ผลิตภัณฑ์เหล่านี้และมีเวลาเผาอยู่ในเกลือมาก แต่หากใช้กระบวนการเผาซินเตอร์ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 300 °C ที่หลอมตัว กับภาชนะเองได้ถ่ายอีกด้วย ดังนั้นจึงมีการพัฒนาเทคนิคการผลิตเซรามิกเหล่านี้ที่อุณหภูมิต่ำลงด้วยการใช้สารช่วยหลอมหรือฟลักซ์ (fluxes) ซึ่งเป็นอนุภาคผงที่เติมลงไปเพื่อทำหน้าที่ช่วยให้ชั้นงานเกิดการหลอมเหลวที่ต่ำกว่าสารองค์ประกอบหลักของผลิตภัณฑ์มากจึงเกิดเป็นเฟสที่เป็นของเหลวให้เคลื่อนย้ายที่ในระหว่างการซินเตอร์ได้รวดเร็วขึ้น



ภาพ 13 พัฒนาการของโครงสร้างจุลภาคที่เกิดจากการซินเตอร์แบบสถานะของแข็ง  
 (ก) อนุภาคผงยึดกันอยู่แบบหลวมๆ หลังการอัดขึ้นรูป (ข) การซินเตอร์ช่วงเริ่มต้น  
 (ค) การซินเตอร์ช่วงกลาง (ง) การซินเตอร์ช่วงสุดท้าย

#### กระบวนการซินเตอร์แบบมีเฟสของเหลวมีอยู่สองระบบคือ

- ระบบที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อซึ้งงานได้รับความร้อนจนกระหึ่งถึงอุณหภูมิของ การซินเตอร์จะมีเฟสที่เป็นของเหลวเกิดขึ้นและคงสภาพอยู่ตลอดช่วงของการซินเตอร์และ เมื่อซึ้งงานเริ่ม เย็นตัวลงเฟสที่เป็นของเหลวนี้จะเกิดการแข็ง ตัวแยกเฟสอยู่ในชึ้นงาน
- ระบบระบบที่มีความเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อซึ้งงานได้รับความร้อนจนกระหึ่งถึงอุณหภูมิของ การซินเตอร์จะมีเฟสที่เป็นของเหลวเกิดขึ้นแล้วค่อยๆ หายไปช้าๆ ด้วยการละลายลงไปอยู่ในเมทริกซ์ของ ชึ้นงาน

#### กระบวนการซินเตอร์ที่มีเฟสของเหลวประกอบด้วย 4 ระยะหลักดังนี้

- ระยะที่อนุภาคมีการจัดเรียงตัวกันใหม่ (particle rearrangement stage) หลังจากที่มีการ หลอมเหลวเกิดขึ้นอนุภาคของแข็งจะถูกแรงดันรูญเล็กจากของเหลวดึงเข้าการกัน ทำให้ชึ้นงานเกิดมีการหด ตัวอย่างรวดเร็ว และมีการกำจัดรูพรุนออกไปจากชึ้นงาน

- ระยะที่อนุภาคมีการแยกออกจากกันแล้วเกิดการตกตะกอนซ้ำ (dissolution reprecipitation stage) มีหลายกรณีที่อนุภาคของแข็งสามารถถลละลายในเฟสที่เป็นของเหลวได้ในระดับ หนึ่ง ซึ่งความโถ้งของอนุภาคของแข็งและความดัน ณ จุดสมดุลระหว่างอนุภาคของแข็งจะช่วยทำให้เกิดมี การแยกออกจากการกันของอนุภาคได้ เมื่อเกิดมีการถลละลายขึ้น ตัวถูกถลละลายจะแพร่เข้าสู่จุดที่มีความโถ้ง ตรงกันข้ามภายในโครงสร้างจุลภาค และเกิดการตกตะกอนจนทำให้เก็บบริเวณดังกล่าวมีขนาดโตขึ้นซึ่ง ตัวที่ตกตะกอนอาจจะไม่ได้เป็นตัวเดียวกันกับอนุภาคของแข็งเริ่มต้นก็ได้แต่อาจจะเป็นตัวใหม่ที่มี องค์ประกอบของห้องที่ได้จากเฟสที่เป็นของแข็งและที่เป็นของเหลวอยู่ร่วมกัน ซึ่งการตกตะกอนในลักษณะ ดังกล่าวนี้จะทำให้ปริมาณเฟสของเหลวที่เกิดขึ้นในระบบลดลงขณะที่มีการตกตะกอน

3. ระยะที่ของเหลวมีการสماналักษณ์ (liquid assimilation) ในบางกรณีของเหลวจะเข้าไปปะปนอยู่ร่วมกับเฟสที่เป็นของแข็งได้โดยตรงด้วยการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีหรืออาจจะเข้าไปแทรกอยู่ด้วยแรงกล จนทำให้เกิดการเป็นของแข็งที่อยู่ในรูปของสารละลายของแข็งที่เกิดจากการดูดซับของเหลวหรือเกิดเฟสใหม่ที่ตกผลึกมาจากสารที่เกิดการหลอมรัฐที่มีการเติบโตของกรนในสถานะของแข็ง (solid state grain growth stage) เมื่อของเหลวถูกตัดออกมาจากอนุภาคที่อัดกันแน่น หรือมีการแพร่ซึมเข้าไปอยู่ภายในของแข็งจะทำให้เกิดมีขอบเกรนปรากว้างขึ้นมา ซึ่งถ้าหากระบบยังมีการซินเตอร์อยู่ก็จะมีพฤติกรรมการเติบโตของกรนเป็นขั้นตอนหลักที่ค่อยควบคุมพุติกรรมของการซินเตอร์ต่อไป

## 2.8 เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-Ray Diffractometer)

เป็นเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุพื้นฐานแบบไม่ทำลาย (non-destructive analysis) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างผลึก การจัดเรียงตัวของอะตอมในโมเลกุลของสารประกอบต่าง ๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยอาศัยหลักการเลี้ยวเบนและการกระเจิงของรังสีเอกซ์และความรู้เกี่ยวกับวิชาระบบโครงสร้างผลึก[9]

รังสีเอกซ์เป็นคลื่นแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีอำนาจการทะลุทะลวงสูง มีความยาวคลื่นสั้นอยู่ในช่วงระหว่าง 0.1 – 100 อังstrom การเกิดอันตรกิริยาของรังสีเอกซ์กับสารนั้นก่อให้เกิดปรากวัตถุการณ์ต่าง ๆ โดยปรากวัตถุการณ์ดังกล่าวล้วนเป็นลักษณะเฉพาะของสารแต่ละชนิด ซึ่งหลักการดังกล่าวเหล่านี้เราจึงสามารถนำมาใช้วิเคราะห์สารได้ดังนี้

1. ใช้วิเคราะห์ทางค่าประกอบของธาตุต่าง ๆ ในสารทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
2. ใช้ศึกษาหาโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดพันธะเคมี
3. ใช้ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างผลึก หรือโมเลกุลของสารด้วยการใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์

รังสีเอกซ์นี้ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติจากการสลายตัวของนิวเคลียสรากมัมมันตังรังสีและที่มนุษย์ผลิตขึ้นจากกลไกทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ เมื่ออะตอมได้รับการกระตุ้นด้วยอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูง วิ่งชนอะตอม ทำให้เกิดอันตรกิริยา ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนขึ้นวงศ์จรต่าง ๆ ของอะตอมมีค่าสูงขึ้น ก็เกิดภาวะเข้าสู่ปกติ โดยมวลของอะตอมไม่เปลี่ยนแปลงปรากวัตถุการณ์ดังกล่าวเป็นกระบวนการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกิน ในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือไฟฟ่อนอกมาในลักษณะพัลส์ (Pulse) จากอะตอมทุกครั้งที่ได้รับการกระตุ้น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปลดปล่อยออกมานี้เรียกว่า “รังสีเอกซ์” ซึ่งแบ่งได้ 2 ชนิด ตามกระบวนการของการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินจากอะตอมบริเวณชั้นโคจรอิเล็กตรอน คือ

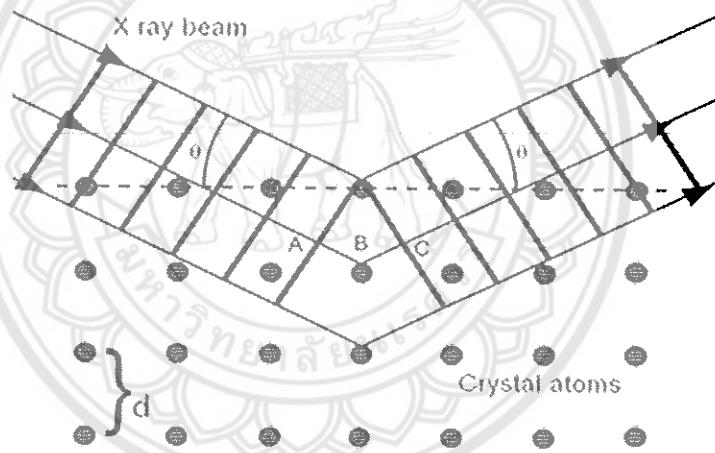
1.รังสีเอกซ์เฉพาะตัว มีลักษณะเป็นรังสีเอกซ์ที่มีพลังงานเดียว (monochromatic X-ray) เพราะเกิดจากการลดระดับพลังงานที่แน่นอน ปรากวัตถุการณ์ของการเกิดรังสีเอกซ์ชนิดนี้เกิดขึ้นเมื่ออิเล็กตรอนหรืออนุภาคที่มีประจุชูนิดอื่น ๆ หรือไฟฟ่อนพลังงานสูงเคลื่อนที่เข้าชนอิเล็กตรอนในวงศ์โคจรชั้นในของอะตอม แล้วถ่ายโอนพลังงานให้อิเล็กตรอน อิเล็กตรอนชั้นในวงศ์โคจรได้รับพลังงานเพิ่มสูงขึ้นกว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของชั้นวงศ์โคจร ทำให้หลุดจากวงโคจรเกิดที่ว่างของอิเล็กตรอนในชั้นวงศ์โคจรชั้น ทำให้อะตอมอยู่ในภาวะที่ถูกกระตุ้นและลดระดับพลังงานลงสู่ภาวะปกติในช่วงระยะเวลาอันสั้น โดยอิเล็กตรอนของวงโคจรในชั้นถัดไปจะลดระดับพลังงานลงมาให้เท่ากับพลังงานยึดเหนี่ยวของวงโคจรชั้นในด้วยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมานิรูปรังสีเอกซ์ แล้วเข้ามาแทนที่ของว่างของวงโคจรชั้นใน พลังงานส่วนเกินนี้จะมีค่าเท่ากับความต่างระดับพลังงานยึดเหนี่ยวเฉพาะวงโคจรของอิเล็กตรอนและชนิดของธาตุนั้น จึงมีพลังงานเฉพาะค่า

2. รังสีแบบต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นรังสีเอกซ์ที่มีพลังงานต่อเนื่องกระจายจากค่าต่ำสุดถึงสูงสุด ปรากฏการณ์ของการเกิดรังสีเอกซ์ต่อเนื่องเกิดจากอิเล็กตรอนพลังงานสูงเคลื่อนเข้าสู่สนามคูลอมบ์ (Coulomb field) บริเวณใกล้นิวเคลียส ความหนาแน่นของสนามไฟฟ้าสถิตย์บริเวณดังกล่าวทำให้อิเล็กตรอนสูญเสียพลังงานอย่างรวดเร็วและปล่อยรังสีเอกซ์ออกมาน

ก่อนที่อิเล็กตรอนปัจจุบันจะทำอันตรกิริยา กับสนามไฟฟ้าบริเวณใกล้นิวเคลียสที่เกิดจากประจุของอะตอม อิเล็กตรอนจะสูญเสียพลังงานบางส่วน อันเนื่องจากการกระเจิงของอิเล็กตรอน ดังนั้น พลังงานของรังสีเอกซ์ที่เกิดขึ้น จึงมีค่ากระเจิงต่ำกว่าเนื่องจากพลังงานต่ำสุดถึงสูงสุดของอิเล็กตรอนปัจจุบัน ถ้าอิเล็กตรอนปัจจุบันมีพลังงานสูงพอที่จะกระตุ้นให้อิเล็กตรอนในวงโคจรชั้นในของอะตอมหลุดออกได้ ก็จะเกิดรังสีเอกซ์เฉพาะค่าประปันช้อนอยู่กับスペกตรัมของรังสีเอกซ์ต่อเนื่องด้วยเสมอ

การปลดปล่อยรังสีเอกซ์ออกมานั้น ค่าความยาวคลื่นได้ ๆ ขึ้นอยู่กับระดับพลังงานที่คายออกมาน ซึ่ง ความยาวคลื่นที่สั้นที่สุดเกิดจากการที่อิเล็กตรอน decay พลังงานที่ได้รับมาทั้งหมดจากแหล่งกำเนิดโดยไม่ขึ้นกับชนิดของเป้าหมายที่ใช้

เมื่อรังสีเอกซ์ตกกระทบผิวน้ำของผลึกโดยทำมุม  $\theta$  บางส่วนของรังสีเอกซ์จะเกิดการกระเจิงด้วย ชั้นของอะตอมที่ผิวน้ำ ลักษณะนี้ของลำรังสีเอกซ์จะผ่านไปยังชั้นที่ 2 ของอะตอม ซึ่งบางส่วนจะกระเจิงและส่วนที่เหลือจะผ่านเข้าไปยังชั้นที่ 3 ของอะตอมแสดงในภาพ 14



ภาพ 14 แบบจำลองสำหรับการพิสูจน์กฎของแบรกค์

ถ้าอะตอมในผลึกมีการจัดเรียงตัวอย่างไม่เป็นระเบียบและมีระยะห่างระหว่างอะตอมเท่าๆ กัน ลำรังสีเอกซ์ที่ผ่านเข้าไปในแต่ละชั้นของอะตอมจะเกิดการเลี้ยวเบนเป็นลักษณะก้น สิ่งสำคัญในการเกิดการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ชั้นอยู่กับภาระ 2 ประการ คือ

1. รังสีที่ตกกระทบ รังสีเลี้ยวเบน และเส้นตั้งฉากกับผิวน้ำจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน
2. ระยะห่างระหว่างชั้นของอะตอมควรมีค่าใกล้เคียงกับความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์ เมื่อปี ค.ศ. 1912 แบรกค์ได้ยิงลำรังสีเอกซ์แคบ ๆ กระทบผิวน้ำผลึกเป็นมุมๆ เพื่อให้เกิดการเลี้ยวเบนและการกระเจิงเมื่อเกิดอันตรกิริยา กับอะตอม  $O$ ,  $P$  และ  $R$  ถ้า

$$SQ + QT = n\lambda \quad (7)$$

เมื่อ  $g$  คือ จำนวนเต็ม รังสีที่กระเจิงจะอยู่ในไฟฟ้าที่ OCD ผลึกจะทำหน้าที่สะท้อนรังสีเอกซ์จะเห็นว่า

$$SQ = QT = d \sin\theta \quad (8)$$

เมื่อ  $d$  คือ ระยะห่างระหว่างชั้นของผลึก เขียนสนการใหม่ได้ว่า

$$n\lambda = 2d \sin\theta \quad (9)$$

เรียกสมการนี้ว่า สมการของแบรกค์ (Bragg's equation) ซึ่งมีประโยชน์มาก สำหรับการศึกษาที่มีโครงสร้างเป็นระเบียบ เช่น สารที่มีโครงสร้างเป็นผลึกเดียว (single crystal) และผลึกเชิงช้อน (polycrystalline) เพราะในสารแต่ละชนิดจะมีรูปแบบการเรียงตัวของอะตอมเป็นลักษณะเฉพาะ เมื่อเราทราบถึงค่ามุมที่เกิดการเลี้ยวเบนไปของรังสีเอกซ์เมื่อชนกับอะตอมของสาร เราจะทราบถึงระยะห่างระหว่างแต่ละอะตอมของสารนั้น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์หาชนิดของสาร (qualitative analysis) รวมไปถึงสมบัติทางกายภาพของสารนั้น ๆ อีกด้วยการคำนวณหาค่าคงที่แลตทิช  $c$ ,  $a$  และค่าอัตราส่วน  $c/a$  สามารถทำได้โดยอาศัยข้อมูลจากเครื่องเอกซเรย์ดิฟเพρερας แล้วจากสมการที่ (9)

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2} \quad (10)$$

ในระบบเทหะรโนนั้น ค่าแลตทิช  $a$  มีค่าเท่ากับแลตทิช  $b$  แต่ไม่เท่ากับแลตทิช  $c$  ( $a = b \neq c$ ) ดังนั้น จากสมการที่ (10) เขียนใหม่ได้เป็น

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + k^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2} \quad (11)$$

หรือ

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = (h^2 + k^2) + \frac{l^2}{(c/a)^2} \quad (12)$$

สำหรับเดดไทหานสามารถคำนวณหาค่าอัตราส่วน  $c/a$  ได้โดยนำค่า  $d$ -spacing  $d_{002}$  และ  $d_{200}$  มาคำนวณตามสมการ (13)

$$c/a = \frac{d_{002}}{d_{200}} \quad (13)$$

## 2.9 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope) [10]

เนื่องจากกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบทั้งแบบใช้แสงธรรมชาติและใช้รังสีแบบอื่น ๆ มีข้อจำกัดในการขยายภาพ เพราะกำลังขยายและกำลังแยกนอกจากจะขึ้นกับลักษณะของเลนส์แล้ว ยังขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นของแสงที่ใช้อีกด้วย กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบสามารถมีกำลังขยายขณะส่องดูวัตถุขนาดเล็กสุดได้เพียง 0.2 ไมโครเมตรเท่านั้น ส่วนกำลังขยายรวมก็ไม่เกิน 2,000 เท่า จึงยังมองเห็นวัตถุภายในเซลล์ที่มีขนาดเล็กเป็นจุด ไม่สามารถแยกรายละเอียดได้ว่าส่วนนั้นเป็นอะไร ต่อมาได้มีการนำเอาอิเล็กตรอนซึ่งมีช่วงคลื่นสั้นกว่าคลื่นของแสงมาก เข้ามาใช้ในการกล้องจุลทรรศน์แทนคลื่นแสง และใช้เลนส์แม่เหล็กแทนเลนส์ประกอบ เรียกกล้องดังกล่าวว่า กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเป็นกล้องที่ใช้ศึกษาโครงสร้างหรือองค์ประกอบพื้นผิวของเซลล์เนื้อเยื่อและวัตถุได้ โดยทำให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของเซลล์หรือวัตถุให้มีความเข้มขึ้นเงาแตกต่างกัน

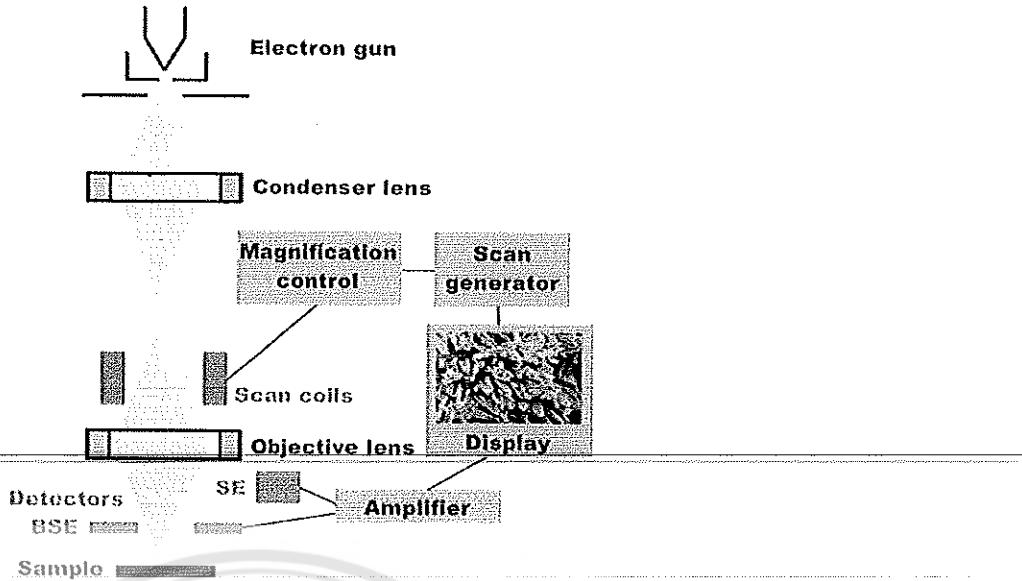
### หลักการเกิดภาพของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

อิเล็กตรอนปฐมภูมิ (primary electron) จากแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอน (electron gun) จะถูกเร่งด้วยศักยไฟฟ้าสูง (1,000 ถึง 3,000 อิเล็กตรอนโวลท์ หรือมากกว่า) ที่สามารถปรับค่าได้ จากนั้นจึงถูกดึงดูดลงสู่เบื้องล่างโดยแผ่นอาโนด (anode plate) ภายใต้ภาวะความดันสูญญากาศ  $10^{-5}$ – $10^{-7}$  ทอร์ และมีชุดคอนเดนเซอร์เลนส์ที่จะปรับลำอิเล็กตรอน (electron beam) ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มของลำอิเล็กตรอน จากนั้นลำอิเล็กตรอนจะวิ่งลงสู่เบื้องล่างผ่านเลนส์วัตถุ ซึ่งทำหน้าที่ในการปรับลำอิเล็กตรอนปฐมภูมิให้มีจุดโฟกัสบนผิwtawoyang พอดี และลำอิเล็กตรอนที่ตกกระทบผิwtawoyang หรือตัวอย่างจะมีขนาดในช่วง 5 ถึง 200 นาโนเมตร โดยมีชุดทดลองความคุณภาพส่องกราด (scan coil) ของลำอิเล็กตรอนทำหน้าที่ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของลำอิเล็กตรอนบนผิwtawoyang ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดได้โดยผ่านทางชุดควบคุม (control unit) ขณะที่ลำอิเล็กตรอนกระทบผิwtawoyang จะเกิดอันตรกิริยา (interaction) ระหว่างอิเล็กตรอนปฐมภูมิกับอะตอมธาตุในวัตถุหรือตัวอย่างและเกิดการถ่ายโอนพลังงานที่ชั้นความลึกจากพื้นผิวที่ระดับต่าง ๆ ทำให้เกิดการปลดปล่อยสัญญาณอิเล็กตรอน (electron signal) ชนิดต่าง ๆ ออกมา ซึ่งใช้ประโยชน์ในการศึกษาลักษณะผิวของตัวอย่างและวิเคราะห์ธาตุที่มีในตัวอย่างได้ตามลักษณะสัญญาณภาพที่ได้จากสัญญาณอิเล็กตรอนชนิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นคือ

1. สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary Electron Image, SEI) หรือเป็นอิเล็กตรอนพลังงานต่ำ 3-5 อิเล็กตรอนโวลต์ เกิดที่พื้นผิวระดับไมลีกิ (ไม่เกิน 10 นาโนเมตร) โดยเกิดกับธาตุที่มีแรงยึดเหนี่ยวอิเล็กตรอนที่ผิวต่ำ

2. สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนระเจิงกลับ (Backscattered Electron Image, BEI) หรือเป็นกลุ่มอิเล็กตรอนที่สัญเสียงพลังงานให้กับอะตอมในชั้นงานเพียงบางส่วนและระเจิงกลับออกมานอกจากพลังงานสูงกว่าอิเล็กตรอนทุติยภูมิ เกิดที่พื้นผิวระดับลึกกว่า 10 นาโนเมตร โดยเกิดได้กับธาตุที่มีเลขอะตอมสูง

3. สัญญาณภาพจากรังสีเอกซ์ (X-Ray Image, XRI) ชนิดที่เป็นรังสีเอกซ์เฉพาะตัวเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากอิเล็กตรอนในระดับชั้นโคจรต่าง ๆ ( $K, L, M, \dots$ ) ถูกกระตุ้น (excited) หรือได้รับพลังงานมากจากหลุดออกจากการโคจรรอบมา ทำให้อะตอมต้องรักษาสมดุลของโครงสร้างรวมภายในอะตอม โดยการดึงอิเล็กตรอนจากชั้นวงโคจรดังไปเข้ามาแทนที่และต้องลดพลังงานส่วนเกินออกมานอกจากรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อทำให้ตัวเองมีพลังงานเท่ากับชั้นโคจรที่ไปแทนที่ ซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้มีความยาวคลื่นเฉพาะในแต่ละธาตุตามระดับพลังงานของตัวอย่างได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ



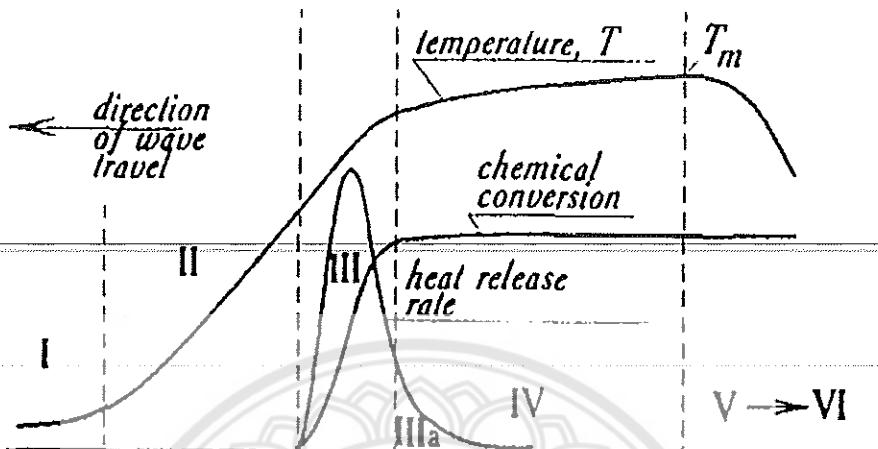
ภาพ 15 องค์ประกอบและหลักการเกิดภาพของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนมาเป็นสัญญาณภาพ平坦บนจอรับภาพได้โดยต้องเลือกใช้อุปกรณ์ในการวัดให้เหมาะสมกับสัญญาณแต่ละชนิด โดยทั่วไปสัญญาณอิเล็กตรอนทุติดภูมิใช้ตัวตรวจวัดชนิดพลาสติกเรืองแสง (Plastic scintillation detector) สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนจะเจิงกลับจะใช้ตัวตรวจวัดที่เป็นสารกึ่งตัวนำชนิดรอยต่อฟีอีน (PN junction detector) หรือตัวตรวจวัดชนิดโรบินสัน (Robinson detector) และในสัญญาณภาพจากรังสีเอกซ์จะใช้หัววัดรังสีชนิดสารกึ่งตัวนำประเทกซิลิโคนลิเทียม (lithium drifted silicon, Si(Li)) ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ในการวิเคราะห์พลังงานของรังสีเอกซ์เฉพาะตัวซึ่งอุปกรณ์วิเคราะห์นั้นมีทั้งแบบช่องเดียว (Single Channel Analyzer, SCA) และอุปกรณ์วิเคราะห์แบบหลายช่อง (Multi Channel Analyzer, MCA)

## 2.10 เทคนิคการเผาไหม้ [11]

การเตรียมผงด้วยวิธีการการเผาไหม้ (combustion) เป็นการใช้ประโยชน์จากการปลดปล่อยพลังงานความร้อนที่ได้จากปฏิกิริยาเคมีในขั้นตอนการผลิต มีการใช้กันมานานแล้วตั้งแต่ศตวรรษที่ผ่านมา เมื่อ Beketov และ Goldshmidt ได้ค้นพบ self-sustaining thermite reaction ซึ่งต่อมาได้ใช้หลักการจุดระเบิดของปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการผลิตอย่างมากmany เช่น ในกระบวนการผลิตเตาหลอมเหล็ก การผลิตเฟอร์โรอัลลอย ฯลฯ อย่างไรก็ตามการพัฒนาทฤษฎีการเผาไหม้ ยุคใหม่ไม่ได้มีรูปแบบอย่างที่เคยปฏิบัติมา (ในปี ค.ศ.1930-1940 สำหรับแก๊ส และปี ค.ศ.1950-1960 สำหรับของเหลว) ในปี ค.ศ.1967 ได้มีการค้นพบปรากฏการณ์จุดระเบิดของของแข็ง ซึ่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะได้ผลผลิตในสถานะของแข็ง และการพัฒนาวิธีการเผาไหม้มันพื้นฐานของ self-propagation high-temperature (SHS) ได้กระตุ้นให้เกิดการทดลองและการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเผาไหม้ของสารประกอบอนินทรีย์และวัสดุอย่างกว้างขวาง ซึ่งผลของข้อมูลที่ได้จากการทดลองได้ถูกนำไปเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีการเผาไหม้และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมกระบวนการเผาไหม้มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวาง สำหรับวัสดุชั้นสูงและกระบวนการผลิตเพื่อการประหยัดพลังงาน ในปัจจุบันการควบคุมความเร็วของการจุดระเบิด อุณหภูมิ

สัดส่วน และโครงสร้างของผลผลิตทำได้โดยการประยุกต์แนวคิดแผนใหม่ของทฤษฎีการเผาไหม้และโครงสร้างจลนพลศาสตร์มหันภาค ของปฏิกริยาเคมี ซึ่งสามารถอธิบายกระบวนการที่ว่าไปของการเผาไหม้ได้ดังภาพ 16



ภาพ 16 การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการการเผาไหม้

ช่วงที่หนึ่ง เป็นช่วงเริ่มต้นของปฏิกริยา ช่วงที่สอง เป็นช่วงก่อนที่จะเกิดปฏิกริยา ซึ่งช่วงนี้จะยังไม่มีปฏิกริยาเกิดขึ้น แต่จะมีการถ่ายเทความร้อนเพิ่มมากขึ้น ช่วงที่สาม เป็นช่วงที่มีความสำคัญต่อโครงสร้างของวัสดุ โดยจะมีการปลดปล่อยพลังงานความร้อนออกมามেื่อเกิดการจุดระเบิด และความร้อนที่ปลดปล่อยออกมานี้จะแพร่ไปสู่ช่วงต้นของช่วงที่สี่ คือ ช่วงการเปลี่ยนแปลงทางเคมี (chemical conversion) ส่วนที่กว้างที่สุดของช่วงนี้ คือ ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงไฟฟ้าและโครงสร้างของวัสดุ ซึ่งชั้นตอนนี้จะเป็นตัวกำหนดโครงสร้างสุดท้ายและมีบทบาทสำคัญต่อสมบัติของวัสดุ ในช่วงที่ห้าของกระบวนการ เป็นช่วงที่วัสดุเกิดการเย็นตัว และในช่วงนี้อาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างของวัสดุ ถ้าการเย็นตัวเกิดขึ้นอย่างช้าๆจะทำให้ได้โครงสร้างของวัสดุที่สมดุล ดังนั้นในกระบวนการการเผาไหม้ อัตราการให้ความร้อนจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของการปลดปล่อยความร้อนและถ่ายเทความร้อนไปสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ส่วนคุณลักษณะของวัสดุที่ได้จะขึ้นอยู่กับไฟฟ้า โครงสร้าง ผื่นไฟ และอัตราการเย็นตัวของวัสดุ

## 2.11 การหาความหนาแน่น (Density)

ความหนาแน่น หมายถึง ค่ามวลต่อปริมาตรของวัสดุ ณ อุณหภูมิหนึ่งๆ หน่วยของความหนาแน่นสามารถเป็นกรัมต่อมิลลิลิตร , กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร , ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต , กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นต้น สำหรับส่วนที่จะได้กล่าวถึงต่อไปนี้จะใช้ในหน่วยของกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งมีความสำคัญทางด้านเชรามิกอย่างยิ่งคือ การอาศัยค่าความหนาแน่นเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพในการอัดแน่นหัวของวัสดุในระหว่างขั้นตอนการขึ้นรูป ซึ่งสูตรที่ใช้ในการคำนวณนั้นยังสามารถนำไปสู่การหาค่าความพรุนของวัสดุได้อีกด้วย

การหาค่าความหนาแน่นของชิ้นงานนั้นอาศัยหลักการของอาร์คิมีเดสที่กล่าวไว้ว่า “เมื่อจุ่มของเข็งลงในของเหลวจะมีแรงพยุงเกิดขึ้นบนของแข็งนั้น โดยแรงพยุงที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของ

ของเหลวที่ถูกแทนที่ด้วยปริมาตรของแข็ง” วิธีการนี้ทำได้โดยการหาค่ามวลของวัตถุในอากาศและขณะที่จุ่มอยู่ในความหนาแน่น

$$\rho = \frac{W_a}{W_a - W_{fl}} \cdot \rho_{fl} \quad (14)$$

เมื่อ  $\rho$  คือ ค่าความหนาแน่นของชิ้นงาน มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

$\rho_{fl}$  คือ ค่าความหนาแน่นของเหลว มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

$W_a$  คือ น้ำหนักแห้งของชิ้นงาน มีหน่วยเป็นกรัม

$W_{fl}$  คือ น้ำหนักแห้งของชิ้นงานในของเหลว มีหน่วยเป็นกรัม

ส่วนการหาความหนาแน่นของเหลวในการนีที่ทราบปริมาตรที่แน่นอนของแข็งลงไปสามารถหาได้จาก

$$\rho_{fl} = G/V \quad (15)$$

โดยที่  $G$  คือ แรงดึงดูดที่เกิดขึ้นกับของแข็ง (หน่วยเป็นกรัม) หาได้จากน้ำหนักของชิ้นงานในอากาศลบด้วยน้ำหนักของชิ้นงานในของเหลว

$V$  คือ ปริมาตรของของแข็งที่จุ่มลงในของเหลว มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร

สำหรับการหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ (relative density):  $\rho_r$  ]นั้น สามารถคำนวณหาได้ตามสมการที่ (16)

$$\rho_r (\%) = \left( \frac{\rho_b}{\rho_{th}} \right) \times 100 \quad (16)$$

เมื่อ  $\rho_r$  คือ ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์

$\rho_b$  คือ ค่าความหนาแน่นของชิ้นงาน มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

$\rho_{th}$  คือ ค่าความหนาแน่นทฤษฎีมีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

## บทที่ 3

### ขั้นตอนการดำเนินการ

#### 3.1 สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง

- โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (Sodium hydrogen carbonate: KHCO<sub>3</sub>) ความบริสุทธิ์ 99.7%
- โซเดียมไนเตรต (Sodium nitrate: NaNO<sub>3</sub>) ความบริสุทธิ์ >99.0%
- ไนโอบิียมเพนตออกไซด์ (Niobium pentoxide: Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) ความบริสุทธิ์ 99.95%
- แอนติมอนไนโตรออกไซด์ (Antimony trioxide; Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) ความบริสุทธิ์ 99.0%
- บิสมัทออกไซด์ (Bismuth oxide: Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) ความบริสุทธิ์ 99.5%
- เซอร์โคโนเนียมออกไซด์ (Zirconium oxide: ZrO<sub>3</sub>) ความบริสุทธิ์ 99.0%
- ไอลซีน (Glycine: NH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>COOH) ความบริสุทธิ์ 98.5%

#### 3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

- กระดาษฟอยล์
- ช้อนตักสาร
- กระปองพลาสติกที่ใช้ผสมสารทำด้วยพอลิเมอร์แบบมีฝาปิดชนิดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 เซนติเมตร ความสูง 10.7 เซนติเมตร
- ลูกบด粗หงอกลักษณะขนาด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-10 มิลลิเมตร
- บีกเกอร์ขนาด 2000 ซีซี
- ตะแกรง漉สารสำหรับกรองเม็ดบดออกจากสารละลาย
- ถ้วยอะลูมินา พร้อมฝาปิด
- พู๊กเบอร์ 7 และจานผสมสี

#### 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

- เครื่องซึ่งสารแบบละเอียด ผลิตโดยบริษัท AND รุ่น HM-330
- เครื่องอัดไฮดรอลิกใช้สำหรับขึ้นรูปสาร อัดแรงดันได้สูงสุด 1000 kgf/cm<sup>3</sup>
- เครื่องบดผสมสารแบบบดย่อยด้วยลูกบด (ball milling)
- เตาเผาสาร CARBOLITE model STF 15/75/450 อุณหภูมิสูงที่สุดในการเผา 1500 องศาเซลเซียส
- แผ่นทำความร้อน (Hot plate)
- ตู้อบสารเย้อ memmert D06057 model 100 อุณหภูมิที่ใช้ในการอบประมาณ 130 องศาเซลเซียส
- แม่พิมพ์สำหรับสร้างรูปทรงที่ต้องการ
- ครกหยกบดสาร

### 3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลอง

1. เครื่องเลี้ยงเบนรังสีเอกซ์ (X-ray diffractrometer)
2. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) และติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ (EDAX) เพื่อตรวจสอบหาธาตุในตัวอย่าง
3. เครื่องวัดสมบัติโพไซโอดิโอเล็กทริก (Piezo d<sub>33</sub> test system model:YE2730)
4. เครื่องวัดสมบัติไดโอลีกทริก (Agilent 4263B LCR meter)
5. เครื่องวัดสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริก (a computer controlled modified sawyer-tower circuit)

### 3.5 ขั้นตอนการทดลอง

#### ตอนที่ 1 การเตรียมผงผลึก KNNS-BNKZ

คำนวณและซึ่งสารตั้งต้นโดยใช้หลักปริมาณสารสัมพันธ์ බอลในกระป๋องพลาสติกที่บรรจุเม็ดabol เติมเอทานอลลงไป ปิดฝ่าแล้ววางบนเครื่องอบดย่อยเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อบดย่อยเสร็จแล้วเทลงบนตะแกรงกรองพร้อมกับนำบีกเกอร์มารองสาร นำสารที่ได้ตั้งบนแผ่นความร้อนที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส นำสารอบให้แห้งด้วยตู้อบความร้อนโดยใช้อุณหภูมิประมาณ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง นำมาบดด้วยครกหยก เพื่อให้ขนาดอนุภาคมีขนาดสม่ำเสมอ แล้วนำผงที่ได้มาบดผสมกับไกลชีนในอัตราส่วน 1 : 2 (สาร : ไกลชีน) นำสารที่บดกับไกลชีนแล้วมาใส่ถ้วยอะลูมินา แล้วนำไปแคลไชน์ที่อุณหภูมิ 650 - 850 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยใช้อัตราขั้นของอุณหภูมิ 3 องศาเซลเซียสต่อนาทีจนถึง 300 องศาเซลเซียส แซทิ้งไว้ 15 นาที จากนั้นใช้อัตราขั้นลง 5 องศาเซลเซียสต่อนาที นำผงที่ได้มาบดอีกรั้งแล้วนำไปศึกษาโครงสร้างของผงโดยใช้เทคนิคการเลี้ยงเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) ศึกษาโครงสร้างจุลภาคโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ( SEM )

#### ตอนที่ 2 การเตรียมเซรามิก KNNS-BNKZ

นำผงผลึกจากตอนที่ 1 มาใส่กระป๋องabolพลาสติกที่บรรจุเม็ดabolอยู่ เติมเอทานอลลง ไปจนน้ำ เติมตัวเชื่อมประสาน (binder) ลงไป 3% โดยน้ำหนัก ปิดฝ่าให้สนิท นำไปวางบนเครื่องอบดย่อย แบบลูกabolเป็นเวลา 12 ชั่วโมง นำสารที่ได้ตั้งบนแผ่นความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 120 องศาเซลเซียส นำสารอบให้แห้งด้วยตู้อบความร้อนโดยใช้อุณหภูมิประมาณ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง บดด้วยครกหยกเพื่อคัดขนาดอนุภาคให้มีความสม่ำเสมอแล้วอัดขึ้นรูปให้เป็นรูปเรียบทรงกระบอกโดยใช้แม่พิมพ์เหล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร โดยใช้ผงผลึก 1.2 กรัมต่อการอัดขึ้นรูป 1 ครั้ง ใช้แรงดันในการอัดขึ้นรูปประมาณ 80 เมกะปascal นำขึ้นงานที่อัดขึ้นรูปมาเรียงในถ้วยอะลูมินาที่มีฝาปิดโดยทำการจัดเรียงเป็นชั้นๆ ซึ่งแต่ ละชั้นจะใส่ผงอะลูมินา แล้วทำการเผาชินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1050-1150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมงโดย ใช้อัตราขั้นลงของอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที ศึกษาศึกษาโครงสร้างเฟสและโครงสร้างจุลภาคของเซรามิกโดยเทคนิคการเลี้ยงเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) หากความหนาแน่นด้วยวิธีการแทนที่น้ำโดย อาศัยหลักการของอาร์คิมีดีส ศึกษาสมบัติไดโอลีกทริกด้วยเครื่อง LCR (ในช่วงอุณหภูมิ 100 ถึง 450 องศาเซลเซียส) แล้ววิเคราะห์ผลและอภิปรายผล

## บทที่ 4

### ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง

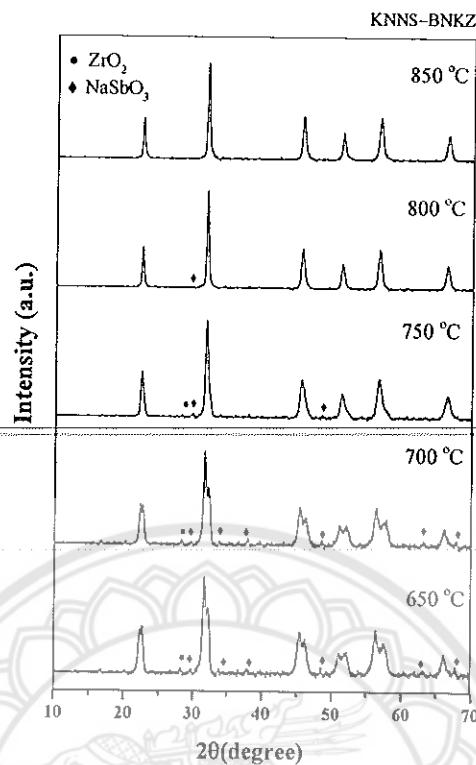
4.1 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray diffractometer: XRD) ของผงผลึก  $0.96(\text{K}_{0.46}\text{Na}_{0.545})\text{Nb}_{0.95}\text{Sb}_{0.05}\text{O}_3 - 0.04\text{Bi}_{0.5}(\text{Na}_{0.82}\text{K}_{0.18})_{0.5}\text{ZrO}_3$  (KNNS-BNKZ)

แบบรูปการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของผงผลึก KNNS-BNKZ ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาไหม้ โดยใช้ไกลชีนเป็นเชื้อเพลิง ในอัตราส่วน 1 : 2 โดยน้ำหนักและใช้อุณหภูมิในการแคลไชน์ระหว่าง 650 ถึง 850 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการเผาแซ่ 2 ชั่วโมง โดยมีอัตราการขันลงของอุณหภูมิเป็น 5 องศาเซลเซียส ต่อนาที โดยแสดงการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุ่ง 20 ระหว่าง 10 ถึง 70 องศา แสดงในภาพ 17 พบร่องผลึก KNNS-BNKZ แสดงโครงสร้างหลักเพอร์โพร์ฟไกท์  $\text{ABO}_3$  เมื่อแคลไชน์ที่อุณหภูมิ 650 ถึง 800 องศาเซลเซียส พบร่องผลึก KNNS-BNKZ ยังเกิดการเผาไหม้ได้ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากพบเฟสแปรกลปломของ  $\text{ZrO}_2$  ที่ทำแน่นมุ่ง 20 เท่ากับ 28.2 องศา (111) ซึ่งตรงกับเพ้มข้อมูลมาตรฐาน (JCPDS) หมายเลข 00-007-0343 และเฟสแปรกลปломของ  $\text{NaSbO}_3$  เกิดขึ้นที่ทำแน่นมุ่ง 20 เท่ากับ 29.6 องศา (104), 33.8 องศา (006), 37.9 องศา (113), 48.5 องศา (11-6), 63.1 องศา (11-9) และ 67.9 องศา(12-7) ตามเพ้มข้อมูลมาตรฐาน (JCPDS) หมายเลข 01-082-2253 เมื่ออุณหภูมิแคลไชน์เพิ่มขึ้นเท่ากับ 850 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ปริมาณเฟสแปรกลปломลดลงและความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นตั้งแต่แสดงในตาราง 1 พบร่องไข่ที่เหมาะสมที่สุดในการเตรียมผงผลึก KNNS-BNKZ คือใช้อุณหภูมิแคลไชน์ 850 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการเผาแซ่ 2 ชั่วโมง และใช้อัตราการขันลงของอุณหภูมิเป็น 5 องศาเซลเซียสต่อนาที เนื่องจากเงื่อนไขดังกล่าวผงผลึกมีความบริสุทธิ์สูงที่สุดเท่ากับ 100 ซึ่งร้อยละความบริสุทธิ์สามารถหาได้จากสมการที่ 17

$$\text{ร้อยละความบริสุทธิ์ของผงผลึก} = \frac{I_{\text{perovskite}}}{I_{\text{perovskite}} + I_{\text{impurity}}} \times 100 \quad (17)$$

เมื่อ  $I_{\text{perovskite}}$  คือ ความเข้มสูงสุดของพีคเพอร์โพร์ฟไกท์ (ในที่นี้หมายถึง KNNS-BNKZ)

$I_{\text{impurity}}$  คือ ความเข้มสูงสุดของพีคเฟสแปรกลปлом (ในที่นี้หมายถึง  $\text{ZrO}_2 + \text{NaSbO}_3$ )



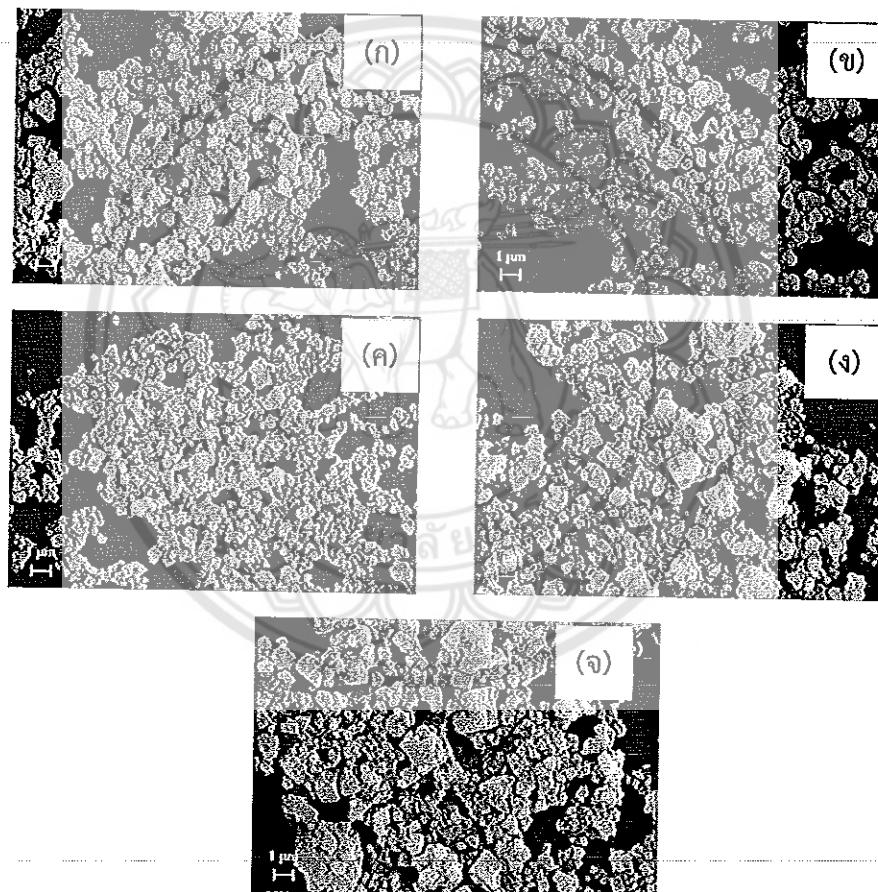
ภาพ 17 แบบรูปการเดี้ยงบนรังสีเอ็กซ์ของผงผลึก KNNS-BNKZ แคลไชน์ที่อุณหภูมิ 650 ถึง 850 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการเผาแข็ง 2 ชั่วโมง โดยมีอัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิเป็น 5 องศาเซลเซียสต่อนาที โดยที่ ( $\blacklozenge$ ) คือ  $NaSbO_3$ , ( $\bullet$ ) คือ  $ZrO_2$

ตาราง 1 ร้อยละความบริสุทธิ์ของผงผลึก KNNS-BNKZ แคลไชน์ที่อุณหภูมิ 650 ถึง 850 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการเผาแข็ง 2 ชั่วโมง

อุณหภูมิแคลไชน์ (°C)	ระยะเวลาในการเผาแข็ง (ชั่วโมง)	ร้อยละความบริสุทธิ์ (%)
650	2	89.46
700	2	90.81
750	2	94.88
800	2	96.44
850	2	100

#### 4.2 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของผงพลีก KNNS-BNKZ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope: SEM)

จากการตรวจวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของผงพลีก KNNS-BNKZ ที่แคลไชน์ระหว่าง 650-850 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมงด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ได้ผลการทดลองดังแสดงในภาพ 18 (ก)-(จ) พบว่าอนุภาคของผงพลีก KNNS-BNKZ เมื่อแคลไชน์ที่อุณหภูมิต่ำ (650-750 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง) มีลักษณะค่อนข้างกลมกระเจยตัว สังเกตได้จากภาพ 19 (ก)-(ค) จากนั้น เมื่อแคลไชน์ผงพลีกที่อุณหภูมิสูงขึ้นตั้งแต่ 800-850 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง (ภาพ 19 (ง)-(จ)) ผงพลีก KNNS-BNKZ เริ่มมีลักษณะค่อนข้างเหลี่ยม โดยอนุภาคเคลื่ยของผงพลีก KNNS-BNKZ มีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออุณหภูมิแคลไชน์สูงขึ้นและมีขนาดอนุภาคเคลื่ยอยู่ระหว่าง 0.414-0.534 ไมโครเมตร ดังแสดงในตาราง 2



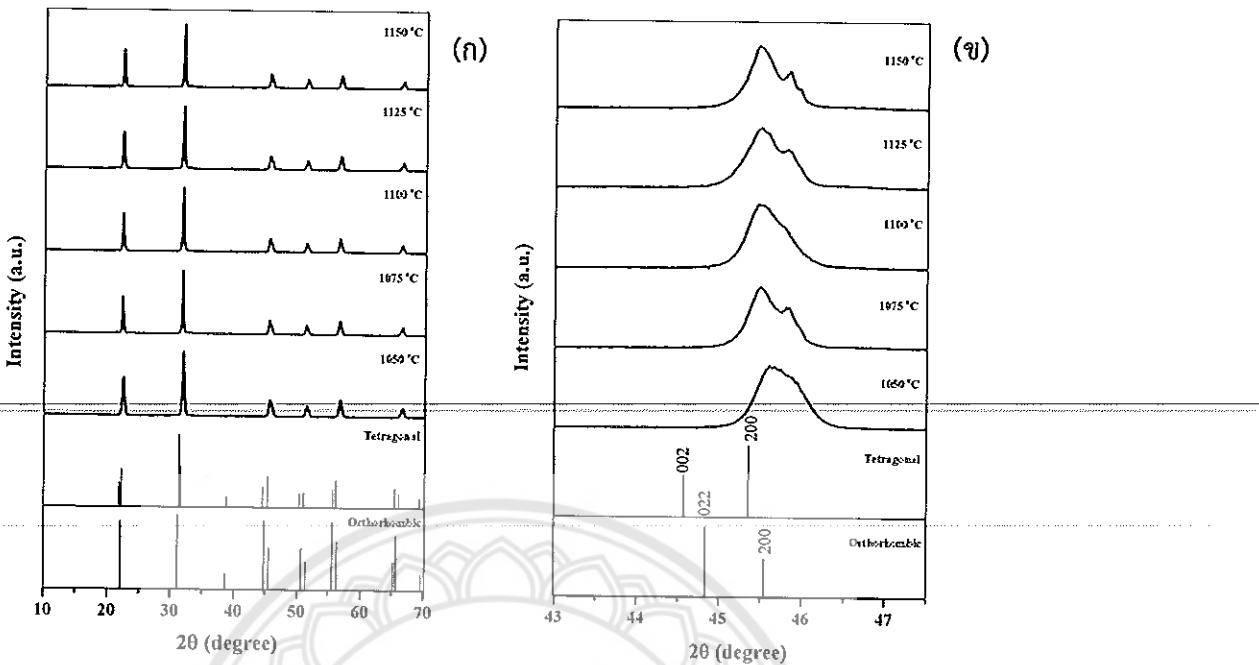
ภาพ 18 ภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคของผงพลีก KNNS-BNKZ แคลไชน์ที่อุณหภูมิ (ก) 650 (ข) 700 (ค) 750 (ง) 800 และ (จ) 850 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ด้วยอัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิเป็น 5 องศาเซลเซียสต่อนาที

ตาราง 2 ขนาดอนุภาคเฉลี่ยของผงผลึก KNNS-BNKZ แคลไชน์ที่อุณหภูมิ 650 - 850 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

อุณหภูมิแคลไชน์ (°C)	ระยะเวลาในการเผาไหม้ (ชั่วโมง)	ขนาดอนุภาคเฉลี่ย ( $\mu\text{m}$ )
650	2	0.414
700	2	0.424
750	2	0.425
800	2	0.495
850	2	0.534

#### 4.3 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray diffractometer: XRD) ของเซรามิก KNNS-BNKZ

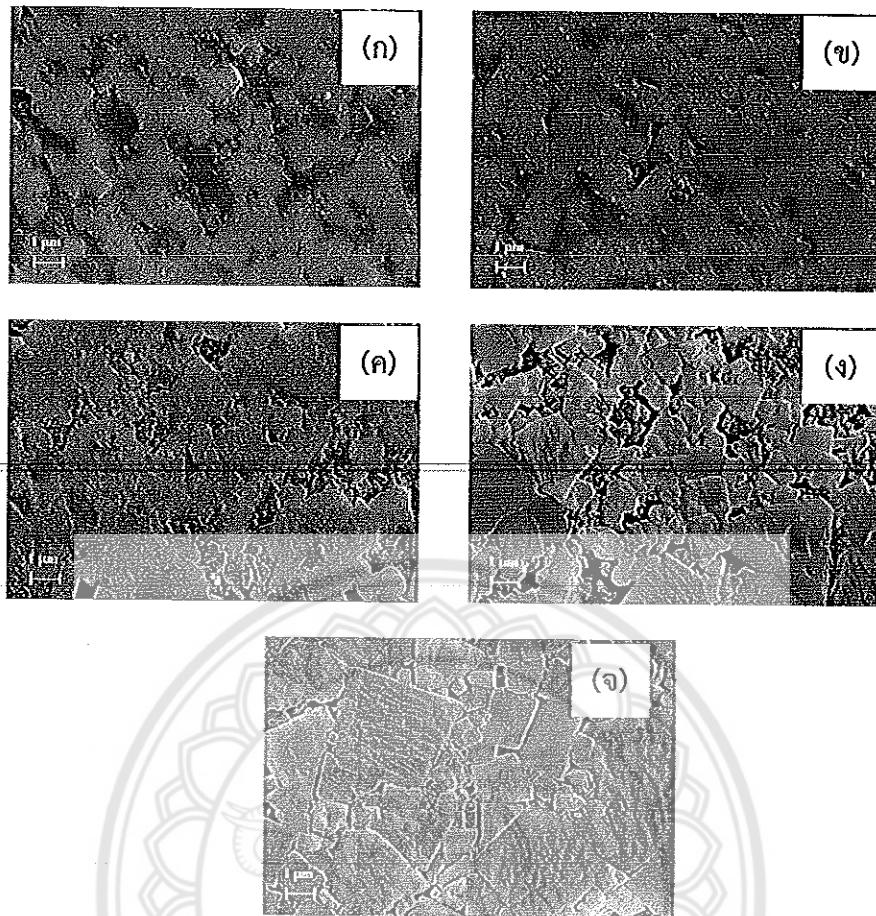
นำผงผลึก KNNS-BNKZ ที่มีความบริสุทธิ์ 100 % โดยใช้เงื่อนไขการแคลไชน์ที่ 850 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง มาอัดขึ้นรูปเป็นเม็ดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร และเผาชินเตอร์ที่อุณหภูมิระหว่าง 1050 ถึง 1150 องศาเซลเซียส ใช้อัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที เป็นเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำเซรามิกที่ผ่านการชินเตอร์มาตรวจสอบโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ พบว่าเซรามิก KNNS-BNKZ แสดงโครงสร้างเฟลสแบบเพอร์ฟลักท์ในทุกตัวอย่าง ดังแสดงในภาพ 19(ก) โดยทั่วไปลักษณะเฉพาะของโครงสร้างแบบเทหะโน๊ตแสดงพีคคู่ของกระบวนการเลี้ยวเบน (002)/(200) ที่มุมประมาณ  $45.5^\circ$  และออร์โรรอมบิกแสดงพีคคู่ของกระบวนการเลี้ยวเบน (022)/(200) ที่มุมประมาณ  $45^\circ$  จากการขยายแบบรูปของการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุมประมาณ  $45^\circ$  ดังแสดงในภาพ 19(ข) พบว่าเซรามิก KNNS-BNKZ ชินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1050-1150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แสดงพีคคู่ของการเลี้ยวเบนที่มุมประมาณ  $45^\circ$  ซึ่งสันนิษฐานว่าเซรามิกเป็นโครงสร้างแบบผสมระหว่างเทหะโน๊ตกับออร์โรรอมบิก เมื่ออุณหภูมิชินเตอร์สูงขึ้นพีคคู่เริ่มแยกกันอย่างชัดเจน โดยตำแหน่งพีคคู่มุ่งตัวของพีคคู่ มีความสูงมากกว่าพีคคูมสูง แสดงให้เห็นว่าเซรามิกมีความเป็นออร์โรรอมบิกเพิ่มขึ้น



ภาพ 19 แบบรูปการเลี้ยงเบนรังสีเอกซ์ของเซรามิก KNNS-BNKZ ที่ชิ้นเตอร์ระห่ำว่าง 1050–1150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง อัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิเป็น 5 องศาเซลเซียสต่อนาที

#### 4.4 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของเซรามิก KNNS-BNKZ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope: SEM)

การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของเซรามิก KNNS-BNKZ ชิ้นเตอร์ที่อุณหภูมิระห่ำว่าง 1050 ถึง 1150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) พบว่า เกรนเซรามิกมีลักษณะเป็นเหลี่ยมในทุกตัวอย่าง ที่อุณหภูมิชิ้นเตอร์ 1050-1100 องศาเซลเซียส เซรามิกมีรูพรุนจำนวนมาก อนุภาคยังเป็นเหลี่ยมได้ไม่สม่ำเสมอเนื่องจากอนุภาคภายในผลึกยังเกิดการผนึกตัว กันไม่หนาแน่นมากนัก (ภาพ 20 (ง)-(จ)) เมื่อเพิ่มอุณหภูมิชิ้นเตอร์สูงขึ้น 1125-1150 องศาเซลเซียส พบว่าปริมาณรูพรุนของผิวเซรามิกลดลงอย่างเห็นได้ชัด เกรนของเซรามิกมีการผนึกตัวที่ดีและมีการเติบโตมากขึ้น ซึ่งกระบวนการที่ขนาดเกรนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่มีการให้ความร้อนนั้น เกิดจากการเคลื่อนตัวของขอบเกรนที่ได้รับแรงขับดัน (driving force) จากความแตกต่างของพลังงานอิสระของเกรน ที่อยู่ระหว่างขอบเกรนทั้งสอง จากการหาค่าขนาดเกรนเฉลี่ยของเซรามิก KNNS-BNKZ พบว่าขนาดเกรนเฉลี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 1.07- 2.05 ไมโครเมตร เมื่ออุณหภูมิชิ้นเตอร์เพิ่มขึ้นดังแสดงในตาราง 3



ภาพ 20 ภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคของเซรามิก KNNS-BNKZ ชิ้นเตอร์ที่อุณหภูมิ (ก) 1050, (ข) 1075, (ค) 1100, (ง) 1125 และ (จ) 1150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง  
อัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิเป็น 5 องศาเซลเซียสต่อนาที

ตาราง 3 ขนาดเกรนเฉลี่ยของเซรามิก KNNS-BNKZ ชิ้นเตอร์ที่อุณหภูมิ 1100 ถึง 1175 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการเผาแซ่ 2 ชั่วโมง

อุณหภูมิชิ้นเตอร์ (°C)	ระยะเวลาในการเผาแซ่ (ชั่วโมง)	ขนาดเกรนเฉลี่ย ( $\mu\text{m}$ )
1100	2	1.07
1125	2	1.10
1150	2	1.13
1160	2	1.48
1175	2	2.05

#### 4.5 ผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของเซรามิก KNNS-BNKZ

นำเซรามิก KNNS-BNKZ ที่ชินเตอร์อุณหภูมิต่างๆมาศึกษาสมบัติทางกายภาพ ความหนาแน่น ผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง 4 พบว่าเมื่ออุณหภูมิชินเตอร์สูงขึ้นค่าความหนาแน่นของเซรามิกจะมีค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากรูพรุนที่อยู่ระหว่างอนุภาคของโครงสร้างผลึกเริ่มถูกกำจัด โดยในระหว่างกระบวนการซินเทอร์จะมีการจัดเรียงตัวใหม่ของอนุภาค ส่งผลให้ออนุภาคของผลึกมีการผนึกตัวกันที่แน่นมากยิ่งขึ้น มีการเคลื่อนของขอบเกรนและทำให้ช่องว่างของรูพรุนเริ่มเกิดการเชื่อมติดกันและถูกกำจัดออกโดยการแพร่ของอากาศจากรูพรุนอุกมตามของขอบของเกรนแล้วหลุดออกจากเนื้อเซรามิก โดยความหนาแน่นของเซรามิกมีค่าสูงสุดประมาณ 4.60 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ดังแสดงในตาราง 4

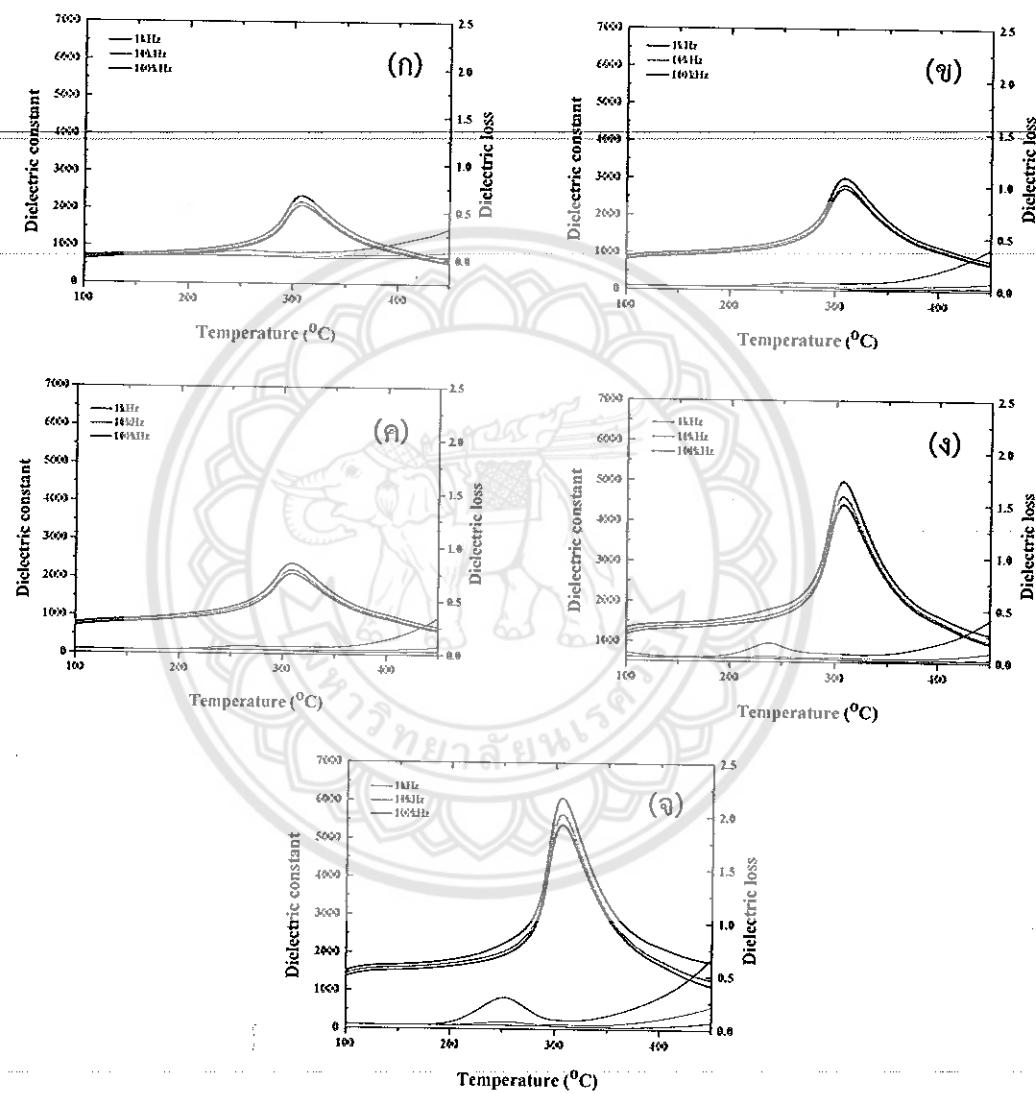
ตาราง 4 ความหนาแน่นและการหดตัวเชิงเส้นของเซรามิก KNNS-BNKZ ชินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1050 ถึง 1150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

อุณหภูมิที่ชินเตอร์ (°C)	ความหนาแน่น (g/cm <sup>3</sup> )
1050	4.48
1075	4.51
1100	4.54
1125	4.60
1150	4.44

#### 4.6 สมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก KNNS-BNKZ ชินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1050-1150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

สมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิก KNNS-BNKZ ชินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1050-1150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ที่ไม่ผ่านการให้สบายนอกเซรามิก KNNS-BNKZ วัด 3 ความถี่ โดยใช้ความถี่ 1, 10 และ 100 กิโลไฮร์ต (kHz) ตามลำดับ แสดงดังภาพ 21 (ก)-(จ) ชินเตอร์อุณหภูมิต่างๆ โดยที่ (ก)= 1050, (ข)= 1075, (ค)= 1100, (ง)= 1125 และ (จ)= 1150 องศาเซลเซียสตามลำดับ จากภาพจะเห็นว่าเส้นกราฟระหว่างค่าคงที่ไดอิเล็กทริกกับอุณหภูมิของตัวอย่าง มีการเปลี่ยนแปลงความโค้งในทุกความถี่ โดยตำแหน่งสูงสุดของเส้นโค้งคืออุณหภูมิที่ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกมีค่าสูงที่สุด (maximum temperature : T<sub>c</sub>) โดยเซรามิก KNNS-BNKZ มีค่า T<sub>c</sub> ประมาณ 310 องศาเซลเซียส แนวโน้มของค่าคงที่ไดอิเล็กทริกมีค่าสูงขึ้น และค่าการศูนย์เสียไดอิเล็กทริกเมื่อพิจารณาจากกราฟเห็นได้ว่ามีแนวโน้มลดลงเมื่อพิจารณาจากอุณหภูมิท้อง เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของผลึกโครงสร้างภายในของเซรามิกที่สอดคล้องกับโครงสร้างจุลภาคและความหนาแน่นของผลึก ซึ่งเซรามิกมีความหนาแน่นสูงนั้นจะมีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่สูงและค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกต่ำ สมบัติไดอิเล็กทริกและความหนาแน่นมีความสัมพันธ์กัน

เนื่องจากปริมาณของ space charge ที่เกิดขึ้นในเซรามิก ขึ้นอยู่กับระยะห่างของช่องว่างผลึก (lattice vacancies) หรือความบริสุทธิ์ของพันธะในอะตอมที่เกิดขึ้นภายในกราน (impurity atoms bounding inside grain boundary) และการก่อรูปของผนังโดเมนซึ่งจะขัดขวางการเกิดโพลาไรเซชัน ด้วยเหตุนี้ ตัวอย่างที่มีความหนาแน่นสูงจะมีปริมาณ space charge ที่น้อย เนื่องจากกรานมีขนาดที่ใหญ่ทำให้กรานซิดกันมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ space charge ที่บริเวณขอบกรานถูกกำจัดออกไป



ภาพ 21 สมบัติอิเล็กทริกของเซรามิก KNNS-BNKZ ชิ้นเตอร์ที่อุณหภูมิ ชิ้นเตอร์ที่อุณหภูมิ (ก) 1050 (ข) 1075 (ค) 1100 (ง) 1125 และ (จ) 1150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

## บทที่ 5

### สรุปผลการวิจัย

#### 5.1 สรุปผลการวิจัย

เตรียมเซรามิก KNNS-BNKZ ด้วยวิธีการเผาใหม้ โดยใช้ไกลซีนเป็นเชื้อเพลิง เผาเคลื่อนที่ อุณหภูมิ 650-850 องศาเซลเซียส ด้วยอัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที พบร้าเมื่อเผาเคลื่อนที่อุณหภูมิ 650-800 องศาเซลเซียส ผงผลึกแสดงโครงสร้างเฟสเพอร์ฟไกร์ พบร์เฟส แปรกลบломของ  $\text{NaSbO}_3$  และ  $\text{ZrO}_2$  เมื่อจากการเกิดปฏิกิริยา yangtze ได้มีสมบูรณ์ เมื่อเพิ่มอุณหภูมิเคลื่อนที่ 850 องศาเซลเซียส พบร้าผงผลึกมีความบริสุทธิ์ 100 เปอร์เซ็นต์ อนุภาคของผงผลึกเมื่อเคลื่อนที่ อุณหภูมิต่ำ (650-750 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง) มีลักษณะค่อนข้างกลมกระ江ายตัวกันค่อนข้าง สม่ำเสมอ เมื่อเคลื่อนที่อุณหภูมิสูงขึ้นตั้งแต่ 800-850 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ผงผลึก เริ่มมีลักษณะค่อนข้างเหลี่ยม โดยอนุภาคเฉลี่ยของผงผลึก มีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออุณหภูมิเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น โดยเงื่อนไขการเตรียมผงผลึกที่ 850 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง เป็นเงื่อนไขในการเคลื่อนที่ดีที่สุด และเมื่อทำการอัดขึ้นรูปและเผาชิ้นเตอร์ที่อุณหภูมิ 1050-1150 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง อัตรา การขึ้นลงของอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสต่อนาที พบร้าเซรามิกแสดงโครงสร้างเฟสแบบสมรรถห่วงเทหะ รงโนลแลดอร์ซีรอมบิก เกรนของเซรามิกมีลักษณะเป็นเหลี่ยมในทุกตัวอย่าง ขนาดเกรนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิชิ้นเตอร์เพิ่มขึ้น และพบว่าเงื่อนไขการชิ้นเตอร์ที่ดีที่สุดในการเตรียมเซรามิก BSZT คือ ใช้อุณหภูมิชิ้นเตอร์ 1125 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เนื่องจากเซรามิกแสดงความหนาแน่นสูงสุด 4.60 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก ( $E_c$ ) 5000 ที่อุณหภูมิครี ( $T_c$ ) 310 องศาเซลเซียส

## บรรณานุกรม

- [1] Ting Zheng ,Jiagang Wu ,Dingquan Xiao & Jianguo Zhu (2015). "Giant  $d_{33}$  in nonstoichiometric (K,Na)NbO<sub>3</sub>-based lead-free ceramics". Scripta Materialia. 94.25-27
- [2] C. wattanawikkam, N. Vittayakron, BongKarn T.(2012). "Low temperature fabrication of lead-free KNN-LS-BS ceramics via the combustion method". Ceramics International 39(2013) s399-s403.
- [3] R. Sumang, C. Wicheanrat, T. Bongkarn, S. Maensiri.(2014). "High densification and properties of lead-free (K<sub>0.5</sub>Na<sub>0.5</sub>)NbO<sub>3</sub> piezoelectric ceramics with optimum excess Na<sub>2</sub>O and K<sub>2</sub>O contents" Ceramics international.(2015)s136-142.
- [4] Jaffe, B., Cook, W. R., & Jaffe, H. (1971). *Piezoelectric Ceramic*. Academic Press, 3, 221- 224.
- [5] Haertling, G. H. (1999). Ferroelectric ceramics: History and technology. *Journal of the American Ceramic Society*, 82, 797-818.
- [6] สุปรีดี พินิจสุนทร. (2558). วัสดุแม่เหล็ก. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- [7] Herbert, J. M. (1985). *Ceramics dielectric and capacitors*. London: Gordon and Breach Scienec publishers.
- [8] สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์. (1992). กระบวนการประดิษฐ์สำหรับเซรามิกขั้นสูง. ใน เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ว. วศ. 210443. เชียงใหม่: ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- [9] สุรินทร์ ลิ่มปนาท, และศรีไนน์ ชุมทด. (2543). เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กชัน, ใน *เครื่องมือวิจัยทางวัสดุ: ทฤษฎีและการทำงานเบื้องต้น*. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- [10] กฤษณ ศิวเลิศกมล. (2545). กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกระดานและอุปกรณ์วิเคราะห์รัตุรงสีเออกซ์, ใน *เครื่องมือวิจัยทางวัสดุ: ทฤษฎีและการทำงานเบื้องต้น*. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- [11] Patil, K. C., Aruna, S. T., & Mirmani, T. (2002). Combustion synthesis: an update. *Current Opinion in Solid State and Materials Science*, 6, 507-512.
- [12] Zhao, Z., Li, X., Ji, H., Dai, Y., & Li, T. (2015). Microstructure and electrical properties in Zn-doped Ba<sub>0.85</sub>Ca<sub>0.15</sub>Ti<sub>0.90</sub>Zr<sub>0.10</sub>O<sub>3</sub> piezoelectric ceramics. *J Alloy Compd*, 637, 291-296.
- [13] Cha, S. H., & Han, Y. H. (2006). Effects of oxygen vacancies on relaxation behavior of Mg-doped BaTiO<sub>3</sub>. *J Appl Phys*, 45, 7797-7800.
- [14] Sun, H., Zhang, Y., Liu, X., Liu, Y., & Chen, W. (2015). Effects of CuO additive on structure and electrical properties of low-temperature sintered Ba<sub>0.98</sub>Ca<sub>0.02</sub>Zr<sub>0.02</sub>Ti<sub>0.98</sub>O<sub>3</sub> lead-free ceramics. *Ceram Int*, 41, 555-565.

- [15] Cai, W., Gao, J., Fu, C., & Tang, L. (2009) Dielectric properties, microstructure and diffuse transition of Ni-doped  $\text{Ba}(\text{Zr}_{0.2}\text{Ti}_{0.8})\text{O}_3$  ceramics. *J Alloy Compd*, 487, 668-674.
- [16] Dai, H., Chen, Z., Xue, R., Li, T., Chen, J., & Xiang, H. (2013). Structural and electric properties of polycrystalline  $\text{Bi}_{1-x}\text{Er}_x\text{FeO}_3$  ceramics. *Ceram Int*, 39, 5373-5378.
- [17] Uchino, K., & Nomura, S. (1982). Critical exponents of the dielectric constants in diffused-phase-transition crystals. *Ferroelectrics*, 44, 55-61.
- [18] Ding, S. H., Chen, T., & Song, T. X. (2009). Dielectric properties of  $\text{Ba}(\text{Ti}_{0.91}\text{Zr}_{0.09})\text{O}_3$  ceramics doped with  $\text{CuO}$ . *Ferroelectrics*, 383, 159-165.
- [19] Ciomaga, C., Viviani, M., Buscaglia, M. T., Buscaglia, V., Mitoseriu, L., Stancu, A., & Nanni, P. (2007). Preparation and characterization of the  $\text{Ba}(\text{Zr}, \text{Ti})\text{O}_3$  ceramics with relaxor properties. *J Eur Ceram Soc*, 27, 4061.
- [20] Cha, S. H., & Han, Y. H. (2006). Effects of oxygen vacancies on relaxation behavior of Mg-doped  $\text{BaTiO}_3$ . *J Appl Phys*, 45, 7797-7800.

